This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-019724

(43) Date of publication of application: 21.01.2000

(51)Int.CI.

G03F 7/004

G03F 7/00

(21) Application number: 10-184783

(71)Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

30.06.1998

(72)Inventor:

KAWAMURA KOICHI

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive composition, exhibiting formability of a contrasty picture without lowering sensitivity, and satisfactory, in particular, in contrast, fuzzy printing, white-light safety, and large development tolerance.

SOLUTION: This composition contains a high-polymer compound having, at least, (a) a fluoro-aliphatic group and (b) an acidic group having hydrogen atoms bonded to carbon atoms neighboring an electron attractive group, and preferably, has, as copolymeric constituents, (a) an additionally polymerizable monomer having a fluoro-aliphatic group and (b) an additionally polymerizable monomer having an acidic group with hydrogen atoms bonded to carbon atoms neighboring an electron attractive group.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-19724

(P2000-19724A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I		テーマコード(参考)
G03F	7/004	504	G03F 7/004	504	2H025
	7/00	503	7/00	503	2H096

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 41 頁)

(21)出願番号	特願平 10-184783	(71)出願人 000005201
		富士写真フイルム株式会社
(22)出顧日	平成10年6月30日(1998.6.30)	神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 川村 浩
		静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
		真フイルム株式会社内
		(74)代理人 100073874
		弁理士 萩野 平 (外4名)
		Fターム(参考) 2H025 AA00 AB03 AC01 AD03 BE01
		CB52 CC20 FA17
		211096 AA08 BA10 BA20 CA03 EA02
		GA08

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 感度を低下させることなく、硬調な画像形成性を示し、特に、硬調で、かつ、焼きぼけ、白灯安全性、および現像許容性の広い満足するべき、感光性組成物を提供する。

【解決手段】 少なくともa. フルオロ脂肪族基、b. 電子吸引性基に隣接した炭素原子に結合した水素原子を有する酸性基を有する高分子化合物を含有することを特徴とし、好ましくは、a. フルオロ脂肪族基を有する付加重合可能なモノマー、b. 電子吸引性基に隣接した炭素原子に結合した水素原子を有する酸性基を有する付加重合可能なモノマーを共重合成分として有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくともa. フルオロ脂肪族基、b. 電子吸引性基に隣接した炭素原子に結合した水素原子を 有する酸性基を有する高分子化合物を含有することを特 徴とする感光性樹脂組成物。

1

【請求項2】 前記高分子化合物が、下記a.、b. で 示される構成単位を共重合成分として有するものである ことを特徴とする請求項1記載の感光性樹脂組成物。

a. フルオロ脂肪族基を有する付加重合可能なモノマ

b. 電子吸引性基に隣接した炭素原子に結合した水素原 子を有する酸性基を有する付加重合可能なモノマー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は新規なフッ素系高分 子(以下、フッ素系ポリマーとも称する)を含有する感 光性樹脂組成物に関するものであり、特に平版印刷版に 有用な感光性樹脂組成物に関し、さらに平版印刷版にお いて硬調な画像形成性を与える感光性樹脂組成物に関す

[0002]

【従来の技術】基板上に感光性樹脂組成物が塗布されて なる平版印刷版は通常露光後、アルカリ現像により露光 部もしくは未露光部を除去し画像を得る。次に印刷過程 に於いて残存した感光性樹脂組成物からなる画像がイン キ受容部として作用し、また溶出したあと現出した基板 が水受容部として作用し印刷物が得られる。この際、良 好な印刷物を得るためには、露光現像後得られる画像が できるだけ画像部と非画像部のディスクリミネーション が高い、すなわち階調が高い(硬調)ものが画像再現 性、および耐傷性の点で好ましく、かつ感度の高く、焼 きぼけ、白灯安全性および現像許容性を満足するべき物 が必要とされる。

【0003】ここで、画像が軟調であるとはステップウ エッジを通して露光し現像したときに画像が残存し始め る段数と完全に膜が残存している段数との差が大きいこ とを意味する。また逆に画像が硬調であるとは画像が残 存し始める段数と完全に膜が残存している段数との差が 小さいことを意味する。

【0004】また焼きぼけとは、感光物の分解により生 40 じたガスによりリスフィルムが浮き上がり完全な密着露 光ができなくなるために生じるものであり、一般的にク リアー感度を同一にしたとき、画像が硬調であるほど焼 きぼけを解消しやすい。また、白灯安全性とは、印刷版 を蛍光灯などの白灯下に曝したときに画像の感度の安定 性を示すものであり、画像が硬調なものほど白灯安全性 が良い。なおステップウエッジとは一段ごとに濃度が 0. 15ずつ変化する短冊形のフィルムであり、露光量 と露光後現像した後の感光層残膜量との関係を得る際に 用いられる。またクリアー感度とは露光現像後画像がで 50

き始めるときの感度を意味する。また現像許容性とは、 現像液の濃度が変化したときに、露光し現像したあとの 画像感度がどれだけ変動するかを観るものであり、感度 の変動が小さいものほど現像許容性がよいという。

【0005】またネガ型平版印刷版として代表される光 重合開始剤と重合可能な2重結合を有するモノマーを含 有する光重合系印刷版、とくに可視光領域のレーザー光 線に対して感度の高いレーザー直接露光型印刷版におい ては、従来階調が軟調であるため印刷版を固定しミラー 10 を高速で回転し露光するインナードラム型のレーザープ レートセッターで画像露光すると、散乱光や反射光によ るカブリが発生しやすかった。印刷版の耐刷力を上げる ために、高いエネルギーで露光したいが、散乱光や反射 光によるカブリがますます悪くなるため、露光量を上げ 耐刷力を上げることができなかった。耐刷力を上げるた めに、高露光量でも散乱光や反射光によるカブリが発生 しないようにする事が必要である。そのためには、階調 を硬調にする事で解決することができる。なぜなら、レ ーザーによる画像露光は、1ドット当たり約1μ秒オー ダーの時間露光されるが、散乱光や反射光によるカブリ は数分のオーダーで極めて弱い光が長時間感光材料にさ らされ、感光層が光硬化するものである。

【0006】よって、感光材料の階調が硬調になると弱 い光では感光材料が光硬化し難く、現像により除去され カブリにならないのである。また赤外線レーザーなどを 用いて描画する感熱型平版印刷版においては画像部と非 画像部のディスクリミネーションが低い、すなわち階調 が低い(軟調)ために素手で触れた部分の画像抜けを生 じたり、また外傷に対する安定性が悪いという問題点が あった。

【0007】これらの問題点を解決するために界面活性 剤を添加する方法がいくつか提示されてきた。たとえば 特開昭59-121044号公報には高感度化したポジ 型感光性樹脂組成物に両性界面活性剤および有機ホウ素 系活性剤を添加することにより現像許容性を広くする方 法が示されている。また特開昭62-251740号公 報には高感度化したポジ型感光性樹脂組成物に非イオン 性界面活性剤を添加することにより現像許容性を広くす る方法が示されている。しかしながら、いずれの方法も ある程度の現像許容性改善の効果はあったが十分なもの ではなく、十分な効果を得ようとすると感度低下を招い た。また焼きぼけ、白灯安全性に関しては効果が得られ なかった。

【0008】また、特開平8-15858号公報には界 面活性剤としてフルオロ脂肪族基、ポリオキシアルキレ ン基、および酸性水素原子基を有するフッ素系ポリマー が記載されている。しかしながら、該公報に具体例とし て記載されているポリマーを用いても焼きぼけ、白灯安 全性に関してはなんら効果が得られなかった。

[0009]

20

30

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の技術 の上記問題点を解決し、感度を低下させることなく、硬 調な画像形成性を示す感光性樹脂組成物を提供しようと するものである。特に、硬調で、かつ、焼きぼけ、白灯 安全性、および現像許容性の広い満足するべき、感光性 樹脂組成物を提供しようとするものである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意研究 を進めた結果、感光性樹脂組成物にある特定のフッ素系 ポリマーを添加することにより、上記目的が達成される ことを見いだした。すなわち本発明は、フッ素系ポリマ ーとして表面活性、親油性、アルカリ可溶性の各部分を 備えた次のような共重合体を感光性樹脂組成物に添加す ると感度を低下させることなく、硬調な画像形成性を示 し、かつ、焼きぼけ、白灯安全性、および現像許容性を 広くしたポジ型感光性樹脂組成物が得られることを見い だした。またこの方法は、従来公知の方法で高感度化し たポジ型感光性樹脂組成物の硬調化に特に有効であり、 本発明によるフッ素系ポリマーを添加することで、軟調 であった画像が硬調化し、焼きぼけ、白灯安全性、およ 20 び現像許容性が改善されることを見いだした。

【0011】また本発明のフッ素系ポリマーを添加する ことによりネガ型平版印刷版では階調が高くなり、とく にレーザー感光性光重合系印刷版においてはレーザー光 に対して高感度でかつ散乱光や反射光によるかぶり性が 良好で高耐刷力を有する印刷版が得られることが判明し た。また感熱型平版印刷版においてはディスクリミネー ションが大きく画像強度が強く従って素手で触れた部分 の画像抜けを起こさず、また外傷に対する安定性が向上 した印刷版が得られることが判明した。

【0012】本発明によるフッ素系ポリマーとは、つぎ の構成からなるポリマーである。

(1) 少なくともa. フルオロ脂肪族基、b. 電子吸引 性基に隣接した炭素原子に結合した水素原子を有する酸 性基を有する高分子化合物。

【0013】(2)下記a.、b. で示される構成単位 を共重合成分として有するものであることを特徴とする 前記高分子化合物。

a. フルオロ脂肪族基を有する付加重合可能なモノマ

b. 電子吸引性基に隣接した炭素原子に結合した水素原 子を有する酸性基を有する付加重合可能なモノマー、

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の特徴をなすフッ素 系ポリマーについて詳細に説明する。本発明で用いるフ ッ素系ポリマーは上記 a 、b の基を有するものならばど んなポリマーの形態でもよい。具体的な形態としてはア クリル樹脂、メタアクリル樹脂、スチリル樹脂、ポリエ ステル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート樹

ことができる。そのうち、アクリル樹脂、メタアクリル 樹脂、スチリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン 樹脂が有用であり、特にアクリル樹脂、メタアクリル樹 脂、ポリウレタン樹脂が有用である。

【0015】アクリル樹脂、メタアクリル樹脂、ポリウ レタン樹脂のうち合成適性の上でアクリル樹脂、メタア クリル樹脂が特に有用であり、以下アクリル樹脂、メタ アクリル樹脂について詳細に記載する。本発明で用いる フッ素系ポリマーが (メタ) アクリル樹脂の場合、次の 10 構成単位を共重合成分として有するものからなる。

a. フルオロ脂肪族基を有する付加重合可能なモノマ

b. 電子吸引性基に隣接した炭素原子に結合した水素原 子を有する酸性基を有する付加重合可能なモノマー、

【0016】先ず、本発明のフッ素系ポリマーの共重合 成分a. である、フルオロ脂肪族基を有する付加重合可 能なモノマーについて説明するについて詳しく述べる。 フルオロ脂肪族基とは、炭素原子上の水素原子がフッ素 化され、通常飽和されかつ一般に1価、2価の脂肪族基 である。これは直鎖、分岐鎖、または環式のものを含 む。フルオロ脂肪族基は本発明の目的において十分な効 果を発揮するためには、3~20、好ましくは6~12 の炭素原子を有し、かつ40重量%以上の好ましくは5 0 重量%以上の、炭素原子に結合したフッ素を有するも のである。好適なフルオロ脂肪族基は、CnF2n+1-

(nは1以上、好ましくは3以上の整数) のように実質 上完全に、または十分にフッ素化されたパーフルオロ脂 肪族基(Rf基とも略す)である。

【0017】成分a. として示されるフルオロ脂肪族基 を有する付加重合可能なモノマーにおける付加重合性モ ノマー部としては、ラジカル重合可能な不飽和基を持つ ビニル単量体が用いられる。これらのビニル単量体のう ち好ましいのもとしてはアクリレート、メタクリレー ト、アクリルアミド、メタクリルアミド、スチレン系、 ビニル系である。フルオロ脂肪族基結合したアクリレー ト、メタクリレートの具体例としては、例えば、Rfー $R' - OOC - C(R'') = CH_2$ (ここでR'は、例え ば、単結合、アルキレン、スルホンアミドアルキレン、 またはカルボンアミドアルキレンであり、R″は水素原 子、メチル基、ハロゲン原子、またはパーフルオロ脂肪 族基)で表される化合物が挙げられる。

【0018】これらの具体例としては例えば米国特許第 2803615号、同第2642416号、同第282 6564号、同第3102103号、同第328290 5号、及び同第3304278号、特開平6-2562 89号、特開昭62-1116号、特開昭62-487 72号、特開昭63-77574号、特開昭62-36 657号に記載のもの及び日本化学会誌 1985 (No. 10) 1884~1888頁記載のものを挙げることがで 脂、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂などを用いる 50 きる。またこれらのフルオロ脂肪族基結合モノマーのほ

かにも、Reports Res. Lab. Asahi Glass Co. Ltd., 34 巻1984年27~34頁記載のフルオロ脂肪族基結合 マクロマーを優位に用いることができる。またフルオロ 脂肪族基結合モノマーとしては、下記構造式の様なパー フルオロアルキル基の長さの異なる混合物であっても用 いることができる。

[0019]

【化1】

$$CH_2 = CH - C - OCH_2CH_2(CF_2)_nF$$

 O $n=6, 8, 10, 12$

【0020】本発明で用いられるフッ素系ポリマー中に用いられるこれらのフルオロ脂肪族基含有ビニル単量体の量は、該フッ素系ポリマーの重量に基づいて3~70重量%であり、好ましくは7~60重量%の範囲である。

【0021】つぎに、本発明のフッ素系ポリマーの共重合成分b. について詳しく述べる。電子吸引性基に隣接した炭素に結合した酸性水素原子を有する酸性基とは下記一般式(1)に示されるものである。

[0022]

【化2】

X、Yは同一であってもまた異なっていていても良く、カルボニル基、アルコキシカルボニル基、スルホニル基、アルコキシスルホニル基、シアノ基、スルホキシド基、アミド基、ヘテロ環基を表わす。もしくはXとYとが結合して窒素原子を含むヘテロ環もしくはカルボニル基を含む非金属原子からなる環を形成していても良い。 Zは水素原子、ハロゲン原子、もしくは窒素、酸素、イオウ原子に結合した非金属原子からなる基を表わす。上記の酸性基を有するモノマーの好ましい構造は下記一般式(2)に示されるものである。

[0023]

【化3】

一般式(2)

$$CH_{2} = \overset{R}{\overset{1}{C}}$$

$$L^{1} \xrightarrow{i} L^{2} \xrightarrow{j} Q$$

【0024】式中、 R^1 は水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基または塩素原子を表わし、 L^1 は-CON (R^2) - (R^2 は水素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基または炭素数 $1\sim 6$ の置換アルキル基を表わす)、-COO-、-NHCO-、-OCO-、

[0025]

【化4】

【0026】(R³、R⁴はそれぞれ独立に、水素、ヒドロキシル、ハロゲン原子または置換もしくは無置換の、アルキル、アルコキシ、アシルオキシもしくはアリールオキシを表わす)、

[0027]

10 【化5】

$$R^3$$
 CON

【0028】 $(R^2, R^3, R^4$ は上記と同じ)を表わし、 L^2 は L^1 とQを結ぶ連結基を表わし、iは0または1を表わしjは0または1を表わし、Qは炭素原子に結合した酸性水素残基を示す。 L^2 で表わされる連結基20 は、具体的には

$$- [X^{1} - (J^{1} - X^{2})_{r} - (J^{2} - X^{3})_{q} - (J^{3})_{s}] -$$

で表わされる。 J¹、 J²、 J³は同じでも異なっていて もよく、-CO-、-SO₂-、-CON (R⁵) - (R ⁵は水素原子、アルキル基(炭素数1~6)、置換アル キル基(炭素数1~6))、-SO₂N(R⁵)-(R⁵ は上記と同義)、-N(R⁵)-R⁶-(R⁵は上記と同 義、R⁶は炭素数1~4のアルキレン基)、-N(R⁵) - R⁶-N(R⁷) - (R⁵、R⁶は上記と同義、R⁷は水 30 素原子、アルキル基 (炭素数1~6)、置換アルキル基 (炭素数1~6) を表わす。)、-O-、-S-、-N (R⁵) - CO-N (R⁷) - (R⁵、R⁷は上記と同 義)、-N(R⁵)-SO₂-N(R⁷)-(R⁵、R⁷は 上記と同義)、-COO-、-OCO-、-N (R⁵) CO₂- (R⁵は上記と同義)、-N (R⁵) CO- (R⁵ は上記と同義) 等を挙げることができる。 X¹、 X²、 X ³は同じでも異なっていてもよく、アルキレン基、置換 アルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、アラ ルキレン基、置換アラルキレン基を表わす。q、rおよ 40 びsは0または1を表わす。

【0029】X¹、X²、X³は互いに同じでも異なっていてもよく、炭素数1~10個の無置換もしくは置換のアルキレン基、アラルキレン基、またはフェニレン基を表わし、アルキレン基は直鎖でも分岐でもよい。アルキレン基としては例えばメチレン、メチルメチレン、ジメチレン、トリメチレン、デシルメチレン、デシルメチレン、ペンタメチレン、ヘキサメチレン、デシルメチレン、アラルキレン基としては例えばベンジリデン、置換もしくは無置換のフェニレン基としては例えばロフェ

50 ニレン、m-フェニレン、メチルフェニレンなどがあ

る。また X^1 、 X^2 、 X^3 で表わされるアルキレン基、アラルキレン基またはフェニレン基の置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アルキル基、置換アルキル基、アルコキシ基、個換アルコキシ基、-NHC OR 8 で表わされる基(R^8 はアルキル、置換アルキル、置換アニール、でラルキル、置換アラルキルを表わす)、 $-NHSO_2R^8$ (R^8 は上記と同義)、 $-SO_2R^8$ (R^8 は上記と同義)、 $-SO_2R^8$ (R^8 は上記と同義)、-CON(R^9)(R^{10})で表わされる基(R^9 、 R^{10} は互いに同 10 じでも異なっていてもよく、水素原子、アルキル、置換アルキル、フェニル、置換フェニル、アラルキル、置換アラルキルを表わす)、 $-SO_2$ (R^9)(R^{10})

(R°、R¹ºは上記と同義)、アミノ基(アルキルで置換されていてもよい)、水酸基や加水分解して水酸基を形成する基が挙げられる。この置換基が2つ以上あるときは互いに同じでも異なってもよい。

【0030】また、上記置換アルキル基、置換アルコキシ基、置換フェニル基、置換アラルキル基の置換基の例としては、水酸基、ニトロ基、炭素数 $1 \sim$ 約4のアルコ 20キシ基、-NHSO $_2$ R 8 (R 8 は上記と同義)、-NHCOR 8 で表わされる基(R 8 は上記と同義)、-CON(R 9) (R 19) (R 9 、R 10 は上記と同義)、-CON(R 9) (R 10) で表わされる基(R 8 、R 10 は上記と同義)、-CON(R 8) (10) で表わされる基(R 8 、R 10 は上記と同義)、-COR 8 (R 8 は上記と同義)、-COR 8 (R 8 は上記と同義)、-COR 8 (R 8 は上記と同義)、 10 以所子、シアノ基、アミノ基(アルキルで置換されていてもよい)等が挙げられる。Qは下記一般式(Cp-1) \sim (Cp-3) のR $_{51}$ \sim R $_{55}$ 、 Z_2 および Z_3 のいずれかの部分で一般式(2)に結合する基を表わすが、R $_{51}$ \sim R $_{55}$ の部分で結合するのが 30画像の耐久性の点でより好ましい。

【0031】 【化6】 一股式(Cp-1)

$$\begin{array}{ccc} & & & \text{O} \\ \text{N} & & \text{II} \\ \text{R}_{51} - \text{C} - \text{CH} - \text{C} - \text{NH} - \text{R}_{52} \\ \text{I} & & \\ \text{Z}_{3} \end{array}$$

一般式(Cp-2)

一般式(Cp-3)

【0032】次に前記一般式 (Cp-1)~ (Cp- のR₅₁~R₅₅について説明する。式中、R₅₁は脂肪 族基、芳香族基、アルコキシ基または複素環基を、R52 およびRҕ₃は各々芳香族基または複素環基を表わす。式 中、R51で表わされる脂肪族基は好ましくは炭素数1~ 22で、置換若しくは無置換、鎖状若しくは環状、いず れであってもよい。脂肪族基への好ましい置換基はアル コキシ基、アリールオキシ基、アミノ基、アシルアミノ 基、ハロゲン原子等でこれらはそれ自体さらに置換基を もっていてもよい。Rsiとして有用な脂肪族基の具体的 な例は、次のようなものである:イソプロピル基、イソ ブチル基、tert-ブチル基、イソアミル基、tert-アミ ル基、1、1-ジメチルブチル基、1、1-ジメチルへ キシル基、1,1-ジエチルヘキシル基、ドデシル基、 ヘキサデシル基、オクタデシル基、シクロヘキシル基、 2-メトキシイソプロピル基、2-フェノキシイソプロ ピル基、2-p-tert-ブチルフェノキシイソプロピル 基、α-アミノイソプロピル基、α-(ジエチルアミ J) イソプロピル基、αー(サクシンイミド) イソプロ 40 ピル基、α- (フタルイミド) イソプロピル基、α-(ベンゼンスルホンアミド) イソプロピル基等である。 【0033】R₅₁、R₅₂またはR₅₃が芳香族基(特にフ エニル基)を表わす場合、芳香族基は置換されていても よい。フェニル基等の芳香族基は炭素数32以下のアル キル基、アルケニル基、アルコキシ基、アルコキシカル ボニル基、アルコキシカルボニルアミノ基、脂肪族アミ ド基、アルキルスルファモイル基、アルキルスルホンア ミド基、アルキルウレイド基、アルキル置換サクシンイ ミド基等で置換されてもよく、この場合アルキル基は鎖 50 中にフェニレンなど芳香族基が介在してもよい。フェニ

ル基はまたアリールオキシ基、アリールオキシカルボニ ル基、アリールカルバモイル基、アリールアミド基、ア リールスルファモイル基、アリールスルホンアミド基、 アリールウレイド基等で置換されてもよく、これらの置 換基のアリール基の部分はさらに炭素数の合計が1~2 2の一つ以上のアルキル基で置換されてもよい。R₅₁、 R₅₂またはR₅₃で表わされるフェニル基はさらに、炭素 数1~6の低級アルキル基で置換されたものも含むアミ ノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、スルホ基、ニ トロ基、シアノ基、チオシアノ基またはハロゲン原子で 10 置換されてもよい。またRs1、Rs2又はRs3は、フェニ ル基が他の環を縮合した置換基、例えばナフチル基、キ ノリル基、イソキノリル基、クロマニル基、クマラニル 基、テトラヒドロナフチル基等を表わしてもよい。これ らの置換基はそれ自体さらに置換基を有してもよい。R 51がアルコキシ基を表わす場合、そのアルキル部分は、 炭素数1から32、好ましくは1~22の直鎖乃至分岐 鎖のアルキル基、アルケニル基、環状アルキル基若しく は環状アルケニル基を表わし、これらはハロゲン原子、 アリール基、アルコキシ基等で置換されていてもよい。 【0034】R₅₁、R₅₂またはR₅₃が複素環基を表わす 場合、複素環基はそれぞれ、環を形成する炭素原子の一 つを介してアルファアシルアセトアミドにおけるアシル 基のカルボニル基の炭素原子またはアミド基の窒素原子 と結合する。このような複素環としてはチオフェン、フ ラン、ピラン、ピロール、ピラゾール、ピリジン、ピラ ジン、ピリミジン、ピリタジン、インドリジン、イミダ ゾール、チアゾール、オキサゾール、トリアジン、チア ジアジン、オキサジンなどがその例である。これらはさ らに環上に置換基を有してもよい。一般式 (Cp-3) においてRssは、炭素数1から32、好ましくは1から 22の直鎖ないし分岐鎖のアルキル基 (例えばメチル、 イソプロピル、tertーブチル、ヘキシル、ドデシル基 等)、アルケニル基(例えばアリル基等)、環状アルキ ル基(例えばシクロペンチル基、シクロヘキシル基、ノ ルボルニル基等)、アラルキル基 (例えばベンジル、β ーフェニルエチル基等)、環状アルケニル基(例えばシ クロペンテニル、シクロヘキセニル基等)を表わし、こ れらはハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アリール 基、アルコキシ基、アリールオキシ基、カルボキシル 基、アルキルチオカルボニル基、アリールチオカルボニ ル基、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボ ニル基、スルホ基、スルファモイル基、カルバモイル 基、アシルアミノ基、ジアシルアミノ基、ウレイド基、 ウレタン基、チオウレタン基、スルホンアミド基、複素 環基、アリールスルホニル基、アルキルスルホニル基、 アリールチオ基、アルキルチオ基、アルキルアミノ基、 ジアルキルアミノ基、アニリノ基、N-アリールアニリ ノ基、N-アルキルアニリノ基、N-アシルアニリノ

もよい。

【0035】更にRssは、アリール基(例えばフェニル 基、α-乃至はβ-ナフチル基等)を表わしてもよい。 アリール基は1個以上の置換基を有してもよく、置換基 として例えばアルキル基、アルケニル基、環状アルキル 基、アラルキル基、環状アルケニル基、ハロゲン原子、 ニトロ基、シアノ基、アリール基、アルコキシ基、アリ ールオキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル 基、アリールオキシカルボニル基、スルホ基、スルファ モイル基、カルバモイル基、アシルアミノ基、ジアシル アミノ基、ウレイド基、ウレタン基、スルホンアミド 基、複素環基、アリールスルホニル基、アルキルスルホ ニル基、アリールチオ基、アルキルチオ基、アルキルア ミノ基、ジアルキルアミノ基、アニリノ基、N-アルキ ルアニリノ基、N-アリールアニリノ基、N-アシルア ニリノ基、ヒドロキシル基等を有してもよい。更にRss は、複素環基(例えばヘテロ原子として窒素原子、酸素 原子、イオウ原子を含む5員または6員環の複素環、縮 合複素環基で、ピリジル基、キノリル基、フリル基、ベ 20 ンゾチアゾリル基、オキサゾリル基、イミダゾリル基、 ナフトオキサゾリル基等)、前記のアリール基について 列挙した置換基によって置換された、複素環基、脂肪族 または芳香族アシル基、アルキルスルホニル基、アリー ルスルホニル基、アルキルカルバモイル基、アリールカ ルバモイル基、アルキルチオカルバモイル基またはアリ ールチオカルバモイル基をあらわしてもよい。

【0036】式中R54は水素原子、1から32、好まし くは1から22の直鎖ないしは分岐鎖のアルキル、アル ケニル、環状アルキル、アラルキル、環状アルケニル基 (これらの基は前記Rssについて列挙した置換基を有し てもよい)、アリール基および複素環基(これらは前記 Rssについて列挙した置換基を有してもよい)、アルコ キシカルボニル基(例えばメトキシカルボニル基、エト キシカルボニル基、ステアリルオキシカルボニル基 等)、アリールオキシカルボニル基(例えばフェノキシ カルボニル基、ナフトキシカルボニル基等)、アラルキ ルオキシカルボニル基(例えばベンジルオキシカルボニ ル基等)、アルコキシ基(例えばメトキシ基、エトキシ 基、ヘプタデシルオキシ基等)、アリールオキシ基(例 えばフェノキシ基、トリルオキシ基等)、アルキルチオ 基 (例えばエチルチオ、ドデシルチオ基等)、アリール チオ基(例えばフェニルチオ基、αーナフチルチオ基 等)、カルボキシル基、アシルアミノ基(例えばアセチ ルアミノ基、3-〔(2、4-ジ-tert-アミルフェノ キシ) アセタミド] ベンズアミド基等) 、ジアシルアミ ノ基、N-アルキルアシルアミノ基(例えばN-メチル プロピオンアミド基等)、N-アリールアシルアミノ基 (例えばN-フェニルアセトアミド基など)、ウレイド 基(例えばウレイド基、Nーアリールウレイド基、Nー 基、ヒドロキシル基、メルカプト基等で置換されていて 50 アルキルウレイド基等)、ウレタン基、チオウレタン

基、アリールアミノ基(例えばフェニルアミノ基、N-メチルアニリン基、ジフェニルアミノ基、N-アセチル アニリノ基、2ークロロー5ーテトラデカンアミドアニ リノ基等)、アルキルアミノ基(例えばn-ブチルアミ ノ基、メチルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基等)、 シクロアミノ基(例えばピペリジノ基、ピロリジノ基 等)、複素環アミノ基(例えば4-ピリジルアミノ基、 2-ベンゾオキサゾリルアミノ基等)、アルキルカルボ ニル基 (例えばメチルカルボニル基等)、アリールカル ボニル基 (例えばフェニルカルボニル基等)、スルホン アミド基(例えばアルキルスルホンアミド基、アリール スルホンアミド基等)、カルバモイル基(例えばエチル カルバモイル基、ジメチルカルバモイル基、N-メチル ーフェニルカルバモイル基、N-フェニルカルバモイル 基など)、スルファモイル基(例えばN-アルキルスル ファモイル基、N, N-ジアルキルスルファモイル基、 N-アリールスルファモイル基、N-アルキル-N-ア リールスルファモイル基、N, N-ジアリールスルファ モイル基等)、シアノ基、ヒドロキシル基、およびスル ホ基のいずれかを表わす。

【0037】上記の炭素原子に結合した酸性水素原子のうち、一般式(Cp-1)において、Rsiがtーブチル基または置換もしくは無置換のアリール基、Rszが置換もしくは無置換のアリール基を表わす場合、および一般式(Cp-2)において、RszおよびRsiが置換もしくは無置換のアリール基を表わす場合が好ましい。また、一般式(Cp-3)におけるRsiがアシルアミノ基、ウレイド基およびアリールアミノ基、Rssが置換アリール基を表わす場合が好ましい。

【0038】 Z₂およびZ₃は、水素原子、ハロゲン原子、酸素原子、窒素原子またはイオウ原子で活性部位に結合している離脱基を表わし、Z₂およびZ₃が酸素原子、窒素原子またはイオウ原子で活性部位に結合している場合には、これらの原子は、アルキル基、アリール基、アリールスルホニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アリールカルボニル基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基とは複素環基と結合しており、さらに窒素原子の場合には、その窒素原子を含み5員又は6員環を形成して離脱基となりうる基をも意味する(例えばイミダソリル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、テトラソリル基など)。

【0039】上記のアルキル基、アリール基、複素環基は、置換基を有していてもよく、具体的には、アルキル基 (例えばメチル基、エチル基など)、アルコキシ基 (例えばメトキシ基、エトキシ基など)、アリールオキシ基 (例えばフェニルオキシ基など)、アルコキシカルボニル基、例えばメトキシカルボニル基など)、アシルアミノ基 (例えばアセチルアミノ基)、カルバモイル基、アルキルカルバモイル基 (例えばメチルカルバモイル基、エチルカルバモイル基など)、ジアルキルカルバモイル基(例えばジメチルカルバモイル基)、アリール 50

カルバモイル基(例えばフェニルカルバモイル基)、アルキルスルホニル基(例えばメチルスルホニル基)、アリールスルホニル基(例えばフェニルスルホニル基)、アルキルスルホンアミド基(例えばメタンスルホンアミド基)、アリールスルホンアミド基(例えばフェニルスルファモイル基(例えばエチルスルファモイル基)、ジアルキルスルファモイル基(例えばジメチルスルファモイル基)、アルキルチオ基(例えばジメチルスルファモイル基)、アルキルチオ基(例えばブメテルチオ基)、アリールチオ基(例えばフェニルチオ基)、シアノ基、ニトロ基、ハロゲン原子(例えばフッ素、塩素、臭素など)が挙げられ、この置換基が2個以上あるときは同じでも異ってもよい。特に好ましい置換基としてはハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、シアノ基が挙げられる。

【0040】 Z_2 、 Z_3 の好ましい基としては、水素原子、ハロゲン原子、窒素原子もしくはイオウ原子で活性部位に結合する基が挙げられる。 Z_3 は下記一般式 (R-1)、(R-2)、(R-3)、又は (R-4) で表20 わされるものである。

$$-OR_{63}$$
 (R-1)

Resは置換してもよいアリール基又は複素環基を表わす。

[0041]

【化7】

30

40

【0042】Rea、Resは、各々水素原子、ハロゲン原子、カルボン酸エステル基、アミノ基、アルキル基、アルキル基、アルキルチオ基、アルコキシ基、アルキルスルホニル基、アルキルスルフィニル基、カルボン酸基、スルホン酸基、無置換もしくは置換フェニル基または複素環を表わし、これらの基は同じでも異なってもよい。

[0043]

【化8】

$$O$$
 N
 O
 $(R-4)$

W1は式中の

【0044】と共に4員環、5員環もしくは6員環を形

成するのに要する非金属原子を表わす。一般式(R-4)のなかで好ましいものとして(R-5) \sim (R-7) が挙げられる。

[0045]

【化9】

【0046】式中、Res、Rerは各々水素原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基ま 20 たはヒドロキシル基を、Res、ResおよびRroは各々水素原子、アルキル基、アリール基、アラルキル基、またはアシル基を、Waは酸素またはイオウ原子を表わす。

【0047】上記モノマーの例としては特開平2-44345号公報中に記載されているものから選ぶことができる。代表的なモノマーを以下に例示するがこれに限定されるものではない。

[0048]

【化10】

M-1

10 M-2

$$CH_2=C$$

$$COOCH_2CH_2$$

$$N$$

$$N$$

$$N$$

$$CI$$

$$CI$$

$$CI$$

M-3

30 [0049] (化11]

M-4 CH₃

M-8

10

20

30

M-10

CH₂
C-CONH
N
O
CI
CI
CH

【0052】 【化14】

M-12

M-11

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 & \text{N} & \text{CH}_3 \\ \text{C-CONH} & \text{N} & \text{CH}_3 \\ \text{N} & \text{N} & \text{CH}_3 \\ \text{CI} & \text{CI} & \text{COCH}_3 \\ \end{array}$$

10

M-13

20

M-14

$$CH_3 - CH_2 COCH_2 CONH - COCH_2 CONH - COCH_2 CONH - COCH_2 CONH_2 CO$$

30

M-18

NHCOCH=CH₂

O

N

CI

O

N

CI

O

N

CI

N

CI

O

O

N

CI

O

O

N

CI

O

C

M-19 $CH_{3} - CH_{3} - CH_{2}$ $CH_{3} - CH_{3} - CH_{3$

【0053】その他、下に示すモノマーも有効に用いることができる。

【化15】

CH₃

CH₂=C

COOCH CH CCH C-CH

$$M-21$$

$$CH_2=CH$$

$$SO_2CH_2CN$$

M-22
$$\begin{array}{c} \text{CH}_2\text{=CH} \\ \\ \text{SO}_2\text{CH}_2\text{CCH}_3 \\ \\ \text{O} \end{array}$$

用いられるこれらの電子吸引性基に隣接した炭素原子に 結合した水素原子を有する酸性基を側鎖に有する単量体 の量は、該フッ素系ポリマーの重量に基づいて5~80 重量%であり、好ましくは20~50重量%の範囲であ る。

【0055】本発明のフッ素系ポリマーは公知慣用の方 法で製造することができる。例えばフルオロ脂肪族基を 有する (メタ) アクリレート (成分a.) および電子吸 引性基に隣接した炭素原子に結合した水素原子を有する 酸性基を有する(メタ)アクリレート(成分b.)を、 有機溶媒中、汎用のラジカル重合開始剤を添加し、熱重 合させることにより製造できる。もしくは、場合により その他の付加重合性不飽和化合物とを、添加して上記と 同じ方法にて製造することができる。

【0056】本発明の目的を達成するためには、本発明 によるフッ素系ポリマーが成分a. およびb. から成る ことが必須であるが、より好ましくはその他の付加重合 不飽和化合物として脂肪族基もしくは芳香族基を有する (メタ) アクリレートもしくは (メタ) アクリルアミド を含有することができる.このような脂肪族基もしくは 20 芳香族基を有する (メタ) アクリレートもしくは (メ タ) アクリルアミドの好ましいものとしては、4個以上 の炭素原子を有する脂肪族基、もしくは芳香族基を有す る(メタ)アクリレートまたは(メタ)アクリルアミド である.

【0057】4個以上の炭素原子を有する脂肪族基とは 1価、2価の脂肪族基を含む。また4個以上の炭素原子 を有する脂肪族基としては、直鎖、分岐鎖、または環式 のものを含む。これらの脂肪族基が本発明の目的におい てより有効に効果を発揮するためには、6-30、好ま 30 しくは8-25の炭素原子を有していることが好まし い。具体的には、n-ヘキシル基、シクロヘキシル基、 nーオクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、 ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、オクタデ シル基などを挙げることができる。また芳香族基として は、炭素原子6-30、好ましくは6-20の炭素原子 を有するものが好ましい。また芳香族基は1個以上の炭 素原子を有する脂肪族基で置換されたものが好ましい。 置換基として用いる1個以上の炭素原子を有する脂肪族 基としては1-20、よりこのましくは4-18の炭素 40 原子を有する、たとえばn-ブチル、t-ブチル、シク ロヘキシル、2-エチルヘキシルなどの直鎖、分岐鎖、ま たは環式の脂肪族基が望ましい.

【0058】また、これらの脂肪族基、および芳香族基 はその他の置換基を有していてもよく、置換基としては ハロゲン原子、アシル、アシルオキシ、アシルアミノ、 アルコキシカルボニル、シアノ、芳香族基などを挙げる ことができる。4個以上の炭素原子を有する脂肪族基お よび/または芳香族基を有するアクリレート、メタクリ レート、アクリルアミドもしくはメタアクリルアミドの 50 ーノニルアクリルアミド、N-デシルアクリルアミド、

具体例としては下記のモノマーを挙げることができる。 【0059】例えばアクリル酸nーブチル、アクリル酸 iso-ブチル、アクリル酸 t -ブチル、アクリル酸ペ ンチル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ノニル、アク リル酸デシル、アクリル酸ラウリル、アクリル酸ステア リル、アクリル酸ベヘニル、アクリル酸ベンジル、アク リル酸メチルベンジル、アクリル酸ジメチルベンジル、 アクリル酸クロロベンジル、アクリル酸ブロモベンジ ル、アクリル酸エチルベンジル、アクリル酸nープロピ 10 ルベンジル、アクリル酸 i s o ープロピルベンジル、ア クリル酸n-ブチルベンジル、アクリル酸iso-ブチ ルベンジル、アクリル酸tert-ブチルベンジル、ア クリル酸フェニル、アクリル酸ナフチル、アクリル酸ト リル、アクリル酸キシリル、アクリル酸クロロフェニ ル、アクリル酸ブロモフェニル、アクリル酸エチルフェ ニル、アクリル酸nープロピルフェニル、アクリル酸i so-プロピルフェニル、アクリル酸n-ブチルフェニ ル、アクリル酸iso-ブチルフェニル、アクリル酸t ert-ブチルフェニルである。好ましくはアクリル酸 ラウリル、アクリル酸ステアリル、アクリル酸ベヘニ ル、アクリル酸tert-ブチルベンジル、アクリル酸 tertーブチル、アクリル酸tertーブチルフェニ

【0060】更にメタクリル酸エステル類をあげること ができる。例えばメタクリル酸nーブチル、メタクリル 酸iso-ブチル、メタクリル酸tert-ブチル、メ タクリル酸ペンチル、メタクリル酸オクチル、メタクリ ル酸ノニル、メタクリル酸デシル、メタクリル酸ラウリ ル、メタクリル酸ステアリル、メタクリル酸ベヘニル、 メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸メチルベンジル、 メタクリル酸ジメチルベンジル、メタクリル酸クロロベ ンジル、メタクリル酸プロモベンジル、メタクリル酸エ チルベンジル、メタクリル酸 n ープロピルベンジル、メ タクリル酸isoープロピルベンジル、メタクリル酸n ーブチルベンジル、メタクリル酸isoーブチルベンシ ル、メタクリル酸tert-ブチルベンジル、メタクリ ル酸フェニル、メタクリル酸ナフチル、メタクリル酸ト リル、メタクリル酸キシリル、メタクリル酸クロロフェ ニル、メタクリル酸ブロモフェニル、メタクリル酸エチ ルフェニル、メタクリル酸n-プロピルフェニル、メタ クリル酸isoープロピルフェニル、メタクリル酸n-ブチルフェニル、メタクリル酸iso-ブチルフェニ ル、メタクリル酸tert-ブチルフェニルである。好 ましくはメタクリル酸ラウリル、メタクリル酸ステアリ ル、メタクリル酸ベヘニル、メタクリル酸tert-ブ チル、メタクリル酸tert-ブチルベンジル、メタク リル酸tertーブチルフェニルである。

【0061】さらにつぎのようなアクリルアミド類、メ タアクリルアミド類を例として挙げることができる。N

Nーラウリルアクリルアミド、Nーステアリルアクリルアミド、Nーノニルメタアクリルアミド、Nーデシルメタアクリルアミド、Nーラウリルメタアクリルアミド、Nーステアリルメタアクリルアミドなど。本発明におけるフッ素系ポリマー中に用いられるこれら4個以上の炭素原子を有する脂肪族基もしくは芳香族基に結合したビニル単量体の量は、該フッ素系ポリマーの重量に基づいて5~70重量%であり、好ましくは10~50重量%の範囲である。

【0062】また本発明のフッ素系ポリマーがアクリル 10 樹脂、メタアクリル樹脂以外の形態で使用される場合に 於いても、成分a., b. の他に、疎水性成分c. とし て脂肪族基または芳香族基を有する成分を重合させる方が平版印刷版のインキ受容性(着肉性)を高める上で望ましい。とくにポリウレタン樹脂の形態で使用するときには、10個以上の直鎖、分岐鎖脂肪族基もしくはアルキレン基、および4個以上の炭素原子を有する脂肪族基で置換された芳香族基から選ばれる少なくとも1つを有する重合体成分であることが望ましい。

【0063】また場合により用いられるその他の付加重 20合不飽和化合物としては、PolymerHandbook 2nd ed.,
J. Brandrup、Wiley Interscience (1975) Chapter 2 Page 1~483記載のものを用いることができる。これらの例としてはたとえば、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、2ークロロエチル(メタ)アクリレート、2ーヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、グリシジル(メタ)アクリレート、などの(メタ)アクリレート類、(メタ)アクリルアミド、Nーエチル(メタ)アクリルアミド、Nープロピル(メタ)アクリルアミド、Nープロピル(メタ)アクリルアミド、Nージメチル(メタ)アクリルアミド、Nーヒドロキシエチル(メタ)アクリルアミドなどの(メタ)アクリルアミド類、酢酸アリル、カプロン酸アリク)アクリルアミド類、酢酸アリル、カプロン酸アリ

ル、ステアリン酸アリル、アリルオキシエタノール等の アリル化合物:

【0064】エチルビニルエーテル、プロピルビニルエ ーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテ ル、メトトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチル ビニルエーテル、2-クロロエチルビニルエーテル、ヒ ドロキシエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテ ル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル、フェニル ビニルエーテル、トリルビニルエーテル、ジエチルアミ ノエチルビニルエーテル等のビニルエーテル類;ビニル アセテート、ビニルブチレート、ビニルカプロエート、 ビニルクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、 ビニルフェニルアセテート、ビニルアセトアセテート、 安息香酸ビニル、クロル安息香酸ビニル等のビニルエス テル類;スチレン、α-メチルスチレン、メチルスチレ ン、ジメチルスチレン、クロルメチルスチレン、エトキ シメチルスチレン、ヒドロキシスチレン、クロルスチレ ン、ブロムスチレン等のスチレン類;

【0065】メチルビニルケトン、エチルビニルケト20 ン、プロピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケトン類;イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン類;その他、クロトン酸ブチル、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、マレイン酸ジメチル、フマル酸ジエチル、Nービニルピロリドン、Nービニルピリジン、アクリロニトリル等が挙げられる。またこれらのモノマーの他、特開昭62-226143号、特開平3-172849号公報記載のポリオキシアルキレン(メタ)アクリレートを用いることができる。【0066】以下、本発明による含フッ素ポリマーの具30 体的な構造の例を示す。なお式中の数字は各モノマー成分のモル比率を示す。

[0067]

【化16】

[0068]

【化17】

[0069]

$$P-9$$

[0070]

30 【化19】

$$\begin{array}{c} P-10 \\ CH_{3} \\ -(CH_{2}C)_{2} \\ C=0 \\ C=0 \\ O-CH_{2}CH_{2}-OCCH_{2}S-(CH_{2}CH)_{10} \\ O \\ C=0 \\ O \\ C=0 \\ C=0 \\ C_{2}H_{4}C_{9}F_{19} \end{array}$$

【0071】本発明で用いるフッ素系ポリマーの分子量 30 の範囲は、平均分子量として3,000~200,00 0のものであり、より好ましくは6,000~100,000のものである。本発明の感光性樹脂組成物におけるフッ素系ポリマーの添加量の範囲は、溶媒を除く全組成分に対して0.001~10重量%が好ましく、0.01~5重量%がより好ましい。

31

【0072】次に本発明による感光性樹脂組成物を調製するに際して必要となる他の成分について説明する。ポジ型感光性樹脂組成物としては、露光の前後で現像液に対する溶解性または膨潤性が変化するものならば使用で40きるが、その中に含まれる好ましいものとしては、oーキノンジアジド化合物が挙げられる。例えば、アルカリ可溶性樹脂とoーキノンジアジド化合物とを含有するポジ型感光性樹脂組成物の場合、oーキノンジアジド化合物は、少なくとも1つのoーキノンジアジド基を有する化合物で、活性光線によりアルカリ水溶液に対する溶解性を増すものが好ましい。

【 0 0 7 3 】この様なものとしては、種々の構造のもの 5 、 1 2 7 号公報に記載されている末端にヒドロキシルが知られており、例えば、J. KOSAR著「Light-Sensitive 基を有するポリエステルに 1 、 2 - + 2 - Systems」(John Wiley & Sons、Inc、1965年発行)P. 33 50 ジアジドー5 - スルホニルクロライドをエステル化させ

6~P. 352に詳細に記載されている。ポジ型感光性樹脂組成物の感光性化合物としては、特に種々のヒドロキシル化合物と o ーベングキノンジアジドあるいは o ーナフトキノンジアジドのスルホン酸エステルが好適である。

【0074】上記のような。-キノンジアジド化合物と しては、例えば、1、2ーナフトキノン-2-ジアジド -5-スルホニルクロライドとフェノール・ホルムアル デヒド樹脂またはクレゾール・ホルムアルデヒド樹脂と のエステル;米国特許第3,635,709号明細書に 記載されている1、2-ナフトキノン-2-ジアジドー 5-スルホニルクロライドとピロガロール・アセトン樹 脂とのエステル;特公昭63-13、528号公報に記 載されている1,2ーナフトキノン-2-ジアジド-5 ースルホニルクロライドとレゾルシンーベンズアルデヒ ド樹脂とのエステル;特公昭62-44, 257号公報 に記載されている1、2-ナフトキノン-2-ジアジド -5-スルホニルクロライドとレゾルシンーピロガロー ル・アセトン共縮合樹脂とのエステル;特公昭56-4 5、127号公報に記載されている末端にヒドロキシル 基を有するポリエステルに1.2-ナフトキノン-2たもの:特公昭50-24、641号公報に記載されているN-(4-ヒドロキシフェニル)メタクリルアミドのホモポリマーまたは他の共重合しうるモノマーとの共重合体に1、2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロライドをエステル化させたもの:特公昭54-29、922号公報に記載されている1、2-ナフトキノン-2-ジアジド-5-スルホニルクロライドとピスフェノール・ホルムアルデヒド樹脂とのエステル:特公昭52-36、043号公報に記載されているp-ヒドロキシスチレンのホモポリマーまたは他の共重合し 10うるモノマーとの共重合体に1、2-ナフトキノン-2ージアジドー5-スルホニルクロライドをエステル化させたもの;1、2-ナフトキノン-2ージアジドー5-スルホニルクロライドとポリヒドロキシベンゾフェノンとのエステルがある。

【0076】 o ーキノンジアジド以外の感光性化合物としてはアルカリ可溶性基を酸分解基で保護した化合物と光酸発生剤との組み合わせからなる化学増幅系の感光物を用いることができる。化学増幅系で用いられる光酸発生剤としては、公知のものを用いることができる。

【0077】たとえば S. I. Schlesinger, Photogr. S ci. Eng., 18, 387(1974) , T. S. Bal etal, Polymer, 21, 423(1980) 等に記載のジアゾニウム塩、米国特許第 4,069,055号、同4,069,056号、特開平3-140140号等に記 載のアンモニウム塩、D. C. Necker etal, Macromolecul es, 17, 2468(1984) 、C. S. Wen etal, Teh, Proc. Con f. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct(1988)、米国特 許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホスホニウ ム塩、J. V. Crivello etal, Macromorecules, 10(6). 1307(1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31(198 8)、欧州特許第104,143号、米国特許第339,049号、同第 410,201号、特開平2-150848号、特開平2-296514号等に 記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello etal, Polymer J. 17, 73(1985), J. V. Crivello etal. J. Org. Che m., 43, 3055(1978), W. R. Wattetal, J. Polymer Sc i., Polymer Chem. Ed., 22, 1789(1984), J. V. Crive lloetal, Polymer Bull., 14, 279(1985), J. V. Criv ello etal, Macromorecules, 14(5), 1141(1981), J.

V. Crivello etal, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877(1979)、欧州特許第370,693 号、米国特許3,902,114 号,欧州特許第233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377号、同410,201号、同339,049号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、獨国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号等に記載のスルホニウム塩、

[0078] J. V. Crivello etal, Macromorecules, 1 0(6), 1307(1977), J. V. Crivello etal, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047 (1979) 等に記載の セレノニウム塩、C. S. Wen etal, Teh, Proc. Conf. R ad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988) 等に記載のア ルソニウム塩等のオニウム塩、米国特許第3,905,815 号、特公昭46-4605号、特開昭48-36281号、特開昭55-32 070号、特開昭60-239736号、特開昭61-169835号、特開 昭61-169837号、特開昭62-58241号、特開昭62-212401 号、特開昭63-70243号、特開昭63-298339号等に記載の 有機ハロゲン化合物、K. Meier etal, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986), T. P. Gill et al, Inorg. Chem., 1 9, 3007(1980) 、D. Astruc, Acc. Chem. Res., 19(1 2), 377(1896)、特開平2-161445号等に記載の有機金属 /有機ハロゲン化物、S. Hayase etal, J. Polymer Sc i., 25, 753(1987), E. Reichmanis etal, J. Pholymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1(1985), Q. Q. Zhu etal, J. Photochem., 36, 85, 39, 317(1987) , B. Am it etal, Tetrahedron Lett., (24), 2205(1973) , D. H. R. Barton etal, J. Chem Soc., 3571(1965), P. M. Collins etal, J. Chem. SoC., Perkin I, 1695(1975) , M. Rudinstein etal, Tetrahedron Lett., (17), 14 45(1975) , J. W. Walker etal J. Am. Chem. Soc., 11 0, 7170(1988), S. C. Busman etal, J. Imaging Technol., 1 1(4), 191(1985), H. M. Houlihan etal, Macormolecules, 2 1, 2001 (1988), P. M. Collins etal, J. Chem. Soc., Chem. Com mun., 532(1972), S. Hayase etal, Macromolecules, 18, 17 99(1985), E. Reichmanis etal, J. Electrochem. Soc., Soli d State Sci. Technol., 130(6), F. M. Houlihan etal, Macr omolcules, 21, 2001 (1988)、欧州特許第0290, 750号、同0 46,083号、同156,535号、同271,851号、同0,388,343号、 米国特許第3,901,710号、同4,181,531号、特開昭60-19 8538号、特開昭53-133022号等に記載の o ーニトロベン ジル型保護基を有する光酸発生剤、

【0079】M. TUNOOK etal, Polymer Preprints Japan, 35(8)、G. Berner etal, J. Rad. Curing, 13(4)、W. J. Mijs etal, Coating Technol., 55(697), 45(1983)、Akzo、H. Adachi etal, Polymer Preprints, Japan, 37(3)、欧州特許第0199, 672号、同84515号、同199, 672号、同044, 115号、同0101, 122号、米国特許第4, 618, 564号、同4, 371, 605号、同4, 431, 774号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特願平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン

酸を発生する化合物、特開昭61-166544 号等に記載のジスルホン化合物を挙げることができる。これらの活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の添加量は、感光性樹脂組成物の全重量(塗布溶媒を除く)を基準として通常0.001~40重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.01~20重量%、更に好ましくは0.1~5重量%の範囲で使用される。これらの光酸発生剤の含有量は、感光性樹脂組成物の全固形分に対して通常0.1~30重量%より好ましくは1~10重量%である。

【0080】またアルカリ可溶性基を酸分解基で保護した化合物としては-C-O-C-または-C-O-Si-結合を有する化合物であり以下の例を挙げることができる。

- a) 少なくとも1つのオルトカルボン酸エステルおよび カルボン酸アミドアセタール群から選ばれるものを含 み、その化合物が重合性を有することができ、上記の群 が主鎖中の架橋要素として、または側方置換基として生 じ得る様な化合物、
- b) 主鎖中に反復アセタールおよびケタール群から選ば 20 れるものを含むオリゴマー性または重合体化合物、
- c)少なくとも一種のエノールエステルまたはN-アシルアミノカーボネート群を含む化合物、
- d) β ケトエステルまたは β ケトアミドの環状アセタールまたはケタール、

【0081】e)シリルエーテル群を含む化合物、

- f)シリルエノールエーテル群を含む化合物、
- g) アルデヒドまたはケトン成分が、現像剤に対して、
- 0. 1~100g/リットルの溶解性を有するモノアセタールまたはモノケタール、
- h) 第三級アルコール系のエーテル、および
- i)第三級アリル位またはベンジル位アルコールのカルボン酸エステルおよび炭酸エステル。

【0082】光照射感応性混合物の成分として、酸によ り開裂し得る種類(a)の化合物は、ドイツ特許公開第 2,610,842号および同第2,928,636号 に記載されている。種類 (b) の化合物を含む混合物 は、ドイツ特許第2、306、248号および同第2、 718, 254号に記載されている。種類 (c) の化合 物は、ヨーロッパ特許公開第0,006,626号およ 40 び同第0,006,627号に記載されている。種類 (d) の化合物は、ヨーロッパ特許公開第0、202, 196号に記載されており、種類 (e) として使用する 化合物は、ドイツ特許公開第3、544、165号およ び同第3,601,264号に記載されている。種類 (「) の化合物は、ドイツ特許公開第3、730、78 5号および同第3、730、783号に記載されてお り、種類(g)の化合物は、ドイツ特許公開第3、73 0. 783号に記載されている。種類(h)の化合物 は、例えば米国特許第4、603、101号に記載され 50

ており、種類(i)の化合物は、例えば米国特許第4,491,628号およびJ. M. Frechetらの論文(J. ImagingSci.30,59-64(1986))にも記載されている。これらの酸分解性基で保護された化合物の含有量は感光性樹脂組成物の全固形分に対して通常 $1\sim60$ 重量%、より好ましくは $5\sim40$ 重量%である。

【0083】水不溶でアルカリ性水溶液に可溶の合成樹 脂(以下、アルカリ可溶性樹脂という)としては、例え ばフェノール・ホルムアルデヒド樹脂、クレゾール・ホ 10 ルムアルデヒド樹脂、フェノール・クレゾール・ホルム アルデヒド共縮合樹脂、フェノール変性キシレン樹脂、 ポリヒドロキシスチレン、ポリハロゲン化ヒドロキシス チレン、N-(4 -ヒドロキシフェニル)メタクリルア ミドの共重合体、ハイドロキノンモノメタクリレート共 重合体の他、特開平7-28244号公報記載のスルホ ニルイミド系ポリマー、特開平7-36184号公報記 載のカルボキシル基含有ポリマーなどが挙げられる。そ の他特開昭51-34711号公報に開示されているよ うなフェノール性水酸基を含有するアクリル系樹脂、特 開平2-866号に記載のスルホンアミド基を有するア クリル系樹脂や、ウレタン系の樹脂等、種々のアルカリ 可溶性の高分子化合物も用いることができる。これらの アルカリ可溶性高分子化合物は、重量平均分子量が50 0~20,000で数平均分子量が200~60,00 0のものが好ましい。かかるアルカリ可溶性の高分子化 合物は1種類あるいは2種類以上を組合せて使用しても よく、全組成物の80重量%以下の添加量で用いられ

【0084】更に、米国特許第4,123,279号明 細書に記載されているように、tーブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、オクチルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような、炭素数3~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮合物を併用することは画像の感脂性を向上させる上で好ましい。かかるアルカリ可溶性樹脂は、通常、組成物全重量の90重量%以下の添加量で用いられる。

【0085】感光性樹脂組成物中には、更に必要に応じて、感度を高めるための環状酸無水物、露光後直ちに可視像を得るための焼き出し剤、画像着色剤としての染料、その他のフィラーなどを加えることができる。

A、pーニトロフェノール、pーエトキシフェノール、 2、3、4ートリヒドロキシベンゾフェノン、4ーヒド ロキシベンゾフェノン、2、4、4′-トリヒドロキシ ベンゾフェノン、4, 4', 4"ートリヒドロキシート リフェニルメタン、4, 4', 3'', 4'' ーテトラヒド ルメタンなどが挙げられる。

【0087】有機酸類としては、特開昭60-8894 2号公報、特開平2-96755号公報などに記載され ている、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸 10 類、ホスホン酸類、ホスフィン酸類、リン酸エステル 類、カルボン酸類などがあり、具体的には、pートルエ ンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、pートル エンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニルホスホン酸、 フェニルホスフィン酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェ ニル、安息香酸、イソフタル酸、アジピン酸、p-トル イル酸、3,4-ジメトキシ安息香酸、フタル酸、テレ フタル酸、1, 4-シクロヘキセン-2, 2-ジカルボ ン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウンデカン酸、アス コルビン酸などが挙げられる。上記の環状酸無水物類、 フェノール類、有機酸類の感光性樹脂組成物中に占める 割合は、0.05~15重量%が好ましく、より好まし くは、0.1~5重量%である。

【0088】露光後、直ちに可視像を得るための焼き出 し剤としては、露光によって酸を放出する感光性化合物 と、酸と塩を形成して色調を変える有機染料との組み合 わせを挙げることができる。

【0089】露光によって酸を放出する感光性化合物と しては、例えば、特開昭50-36,209号公報に記 載されているo-ナフトキノンジアジド-4-スルホン 30 酸ハロゲニド;特開昭53-36223号公報に記載さ れているトリハロメチルー2ービロンやトリハロメチル - s - トリアジン;特開昭55-62444号公報に記 載されている種々のo-ナフトキノンジアジド化合物; 特開昭55-77742号公報に記載されている2-ト リハロメチルー5-アリールー1、3、4-オキサジア ゾール化合物;ジアゾニウム塩などを挙げることができ る。これらの化合物は、単独または混合して使用するこ とができ、その添加量は、組成物全重量に対し、0.3 ~15重量%の範囲が好ましい。

【0090】本発明における、感光性樹脂組成物中に は、光分解して酸性物質を発生する化合物の光分解生成 物と相互作用することによってその色調を変える有機染 料が少なくとも一種類以上用いられる。このような有機 染料としては、ジフェニルメタン系、トリアリールメタ ン系、チアジン系、オキサジン系、フェナジン系、キサ ンテン系、アントラキノン系、イミノナフトキノン系、 アゾメチン系の色素を用いることができる。具体的には 次のようなものである。

バイオレット、エリスロシンB、メチルグリーン、ゥリ スタルパイオレット、ベイシックフクシン、フェノール フタレイン、1,3ージフェニルトリアジン、アリザリ ンレッドS、チモールフタレイン、メチルバイオレット 2 B、キナルジンレッド、ローズベンガル、チモールス ルホフタレイン、キシレノールブルー、メチルオレン ジ、オレンジIV、ジフェニルチオカルバゾン、2、7-ジクロロフルオレセイン、パラメチルレッド、コンゴー レッド、ベンゾプルプリン4B、α-ナフチルレッド、 ナイルブルー2B、ナイルブルーA、フエナセタリン、 メチルバイオレット、マラカイトグリーン、パラフクシ ン、オイルブルー#603〔オリエント化学工業(株) 製〕、オイルピンク#312 [オリエント化学工業

(株) 製〕、オイルレッド5B [オリエント化学工業 (株) 製〕、オイルスカーレット#308 [オリエント 化学工業(株)製〕、オイルレッドOG〔オリエント化 学工業 (株) 製〕、オイルレッドRR [オリエント化学 工業(株)製〕、オイルグリーン#502 [オリエント 化学工業(株) 製]、スピロンレッドBEHスペシャル 〔保土谷化学工業(株)製〕、ビクトリアピュアーブル -BOH 〔保土谷化学工業 (株) 製〕、

【0092】パテントピュアーブルー〔住友三国化学工 業(株)製〕、スーダンブルーII [BASF社製]、m ークレゾールパープル、クレゾールレッド、ローダミン B、ローダミン6G、ファーストアッシドバイオレット R、スルホローダミンB、オーラミン、4-p - ジェチ ルアミノフェニルイミノナフトキノン、2-カルボキシ アニリノー4-p-ジエチルアミノフェニルイミノナフ トキノン、2-カルボステアリルアミノ-4-p-ジヒ ドロオキシエチルーアミノーフェニルイミノナフトキノ ン、p-メトキシベンゾイル-p'-ジエチルアミノo' -メチルフェニルイミノアセトアニリド、シアノー p-ジエチルアミノフェニルイミノアセトアニリド、1 -フェニル-3-メチル-4-p-ジエチルアミノフェ ニルイミノー5ーピラゾロン、1ーβーナフチルー4ー p-ジエチルアミノフェニルイミノ-5-ピラゾロン

【0093】特に好ましい有機染料は、トリアリールメ タン系染料である。トリアリールメタン系染料では、特 40 開昭62-2932471号公報、特願平4-1128 4.4号明細書に示されているような対アニオンとしてス ルホン酸化合物を有するものが特に有用である。これら の染料は単独又は混合して使用することができ、添加量 は感光性樹脂組成物の総重量に対して 0.3~15重量 %が好ましい。また必要に応じて他の染料、顔料と併用 でき、その使用量は染料及び顔料の総重量に対して70 重量%以下、より好ましくは50重量%以下である。

【0094】次に本発明の感光性樹脂組成物において、 ネガ型印刷版である光重合性印刷版の感光層として用い 【0091】ブリリアントグリーン、エオシン、エチル 50 られる場合の感光性樹脂組成物について説明する。本発

明の感光性樹脂組成物が光重合性感光性樹脂組成物であ る場合の、その主な成分としては、前記フッ素系ポリマ 一の他、付加重合可能なエチレン性二重結合を含む化合 物、光重合開始剤等であり、必要に応じ、熱重合禁止剤 等の化合物が添加される。

【0095】付加重合可能な二重結合を含む化合物は、 末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1個、好ましく は2個以上有する化合物の中から任意に選択することが できる。例えばモノマー、プレポリマー、すなわち2量 体、3量体およびオリゴマー、またはそれらの混合物な 10 らびにそれらの共重合体などの化学的形態をもつもので ある。モノマーおよびその共重合体の例としては、不飽 和カルボン酸(例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イ タコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸な ど)と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽 和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド等が あげられる。

【0096】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カル ボン酸とのエステルのモノマーの具体例としては、アク リル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレ 20 ート、トリエチレングリコールジアクリレート、1、3 ーブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリ コールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリ レート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート、トリメチロール プロパントリ (アクリロイルオキシプロピル) エーテ ル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘキサン ジオールジアクリレート、1,4-シクロヘキサンジオ ールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアク リレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペン 30 タエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリト ールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールジア クリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレー ト、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ソル ビトールトリアクリレート、ソルビトールテトラアクリ レート、ソルビトールペンタアクリレート、ソルビトー ルヘキサアクリレート、トリ (アクリロイルオキシエチ ル) イソシアヌレート、ポリエステルアクリレートオリ ゴマー等がある。

【0097】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ 40 チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ レングリコールジメタクリレート、1、3-ブタンジオ*

 $CH_2=C$ (R₅) $COOCH_2CH$ (R₆) OH

(ただし、RsおよびReはHあるいはCHsを示す。) 【0101】また、特開昭51-37193号に記載さ れているようなウレタンアクリレート類、特開昭48*ールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレ ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタ エリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジ メタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタク リレート、ジペンタエリスリトールペンタメタアクリレ ート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビトール テトラメタクリレート、ビス〔p-(3-メタクリルオ キシー2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル]ジメチル メタン、ビスー〔p-(メタクリルオキシエトキシ)フ エニル〕ジメチルメタン等がある。

【0098】イタコン酸エステルとしては、エチレング リコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタ コネート、1、3-ブタンジオールジイタコネート、 1, 4-ブタンジオールジイタコネート、テトラメチレ ングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジ イタコネート、ソルビトールテトライタコネート等があ

【0099】クロトン酸エステルとしては、エチレング リコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジ クロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、 ソルビトールテトラジクロトネート等がある。イソクロ トン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソク ロトネート、ペンタエリスリトールジイソクロトネー ト、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。マ レイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレ ート、トリエチレングリコールジマレート、ペンタエリ スリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等 がある。さらに、前述のエステルモノマーの混合物もあ げることができる。

【0100】また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和カ ルボン酸とのアミドのモノマーの具体例としては、メチ レンビスーアクリルアミド、メチレンビスーメタクリル アミド、1,6-ヘキサメチレンビス-アクリルアミ ド、1,6-ヘキサメチレンビス-メタクリルアミド、 ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレ ンビスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリルアミ ド等がある。その他の例としては、特公昭48-417 08号公報中に記載されている1分子中に2個以上のイ ソシアネート基を有するポリイソシアネート化合物に、 下記の一般式(A)で示される水酸基を含有するビニル モノマーを付加せしめた1分子中に2個以上の重合性ビ ニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられ

(A)

-30490号各公報に記載されているようなポリエス テルアクリレート類、エポキシ樹脂と (メタ) アクリル 酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のア 64183号、特公昭49-43191号、特公昭52 50 クリレートやメタクリレートをあげることができる。さ

らに日本接着協会誌 vol. 20、No. 7、300~30 8ページ(1984年)に光硬化性モノマーおよびオリ ゴマーとして紹介されているものも使用することができ る。なお、これらの使用量は、全成分に対して5~70 重量%(以下%と略称する。)、好ましくは10~50 %である。

【0102】本発明で用いられる光重合性の感光性樹脂 組成物に含まれる光重合開始剤としては、使用する光源 の波長により、特許、文献等で公知である種々の光重合 開始剤、あるいは2種以上の光重合開始剤の併用系(光 10 重合開始系)を適宜選択して使用することができる。例 えば400 n m付近の光を光源として用いる場合、ベン ジル、ベンゾインエーテル、ミヒラーズケトン、アント ラキノン、チオキサントン、アクリジン、フェナジン、 ベンゾフェノン等が広く使用されている。

【0103】また、400nm以上の可視光線、Arレ ーザー、半導体レーザーの第2高調波、SHG-YAG レーザーを光源とする場合にも、種々の光重合開始系が 提案されており、例えば、米国特許第2,850,44 5号に記載のある種の光還元性染料、例えばローズベン 20 ガル、エオシン、エリスロシンなど、あるいは、染料と 光重合開始剤との組み合わせによる系、例えば、染料と アミンの複合開始系 (特公昭44-20189号)、へ キサアリールビイミダゾールとラジカル発生剤と染料と の併用系(特公昭45-37377号)、ヘキサアリー ルビイミダゾールと p ージアルキルアミノベンジリデン ケトンの系 (特公昭47-2528号、特開昭54-1 55292号)、環状シスーαージカルボニル化合物と 染料の系(特開昭48-84183号)、環状トリアジ ンとメロシアニン色素の系(特開昭54-151024 30 号)、3-ケトクマリンと活性剤の系(特開昭52-1 12681号、特開昭58-15503号)、ビイミダ ゾール、スチレン誘導体、チオールの系 (特開昭59-140203号)、有機過酸化物と色素の系(特開昭5 9-1504号、特開昭59-140203号、特開昭 59-189340号、特開昭62-174203号、 特公昭62-1641号、米国特許第4766055 号)、染料と活性ハロゲン化合物の系(特開昭63-2 58903号、特開平2-63054号など)、

【0104】染料とボレート化合物の系(特開昭62-143044号、特開昭62-150242号、特開昭 64-13140号、特開昭64-13141号、特開 昭64-13142号、特開昭64-13143号、特 開昭64-13144号、特開昭64-17048号、 特開平1-229003号、特開平1-298348 号、特開平1-138204号など)、ローダニン環を 有する色素とラジカル発生剤の系(特開平2-1796 43号、特開平2-244050号)、チタノセンと3 ーケトクマリン色素の系(特開昭63-221110

いはウレタン基を含む付加重合可能なエチレン性不飽和 化合物を組み合わせた系(特開平4-221958号、 特開平4-219756号)、チタノセンと特定のメロ シアニン色素の系(特開平6-295061号)、チタ ノセンとベンゾピラン環を有する色素の系 (特開平8-334897号) 等を挙げることができる。これらの光 重合開始剤の使用量は、エチレン性不飽和化合物100 重量部に対し、0.05~100重量部、好ましくは 0.1~70重量部、更に好ましくは0.2~50重量 部の範囲で用いることができる。

【0105】また、本発明の光重合性の感光性樹脂組成 物においては、以上の基本成分の他に感光性樹脂組成物 の製造中あるいは保存中において重合可能なエチレン性 不飽和化合物の不要な熱重合を阻止するために少量の熱 重合禁止剤を添加することが望ましい。適当な熱重合禁 止剤としてはハロイドキノン、p-メトキシフェノー ル、ジーtーブチルーpークレゾール、ピロガロール、 t-ブチルカテコール、ベンゾキノン、4,4'-チオ $\forall x (3-x) \neq (1-x) = (1-x) \neq (1-x) \neq$ 2'-メチレンビス (4-メチル-6-t-ブチルフェ ノール)、N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミン第 ーセリウム塩、N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミ ンアルミニウム塩等があげられる。熱重合禁止剤の添加 量は、全組成物の重量に対して約0.01%~約5%が 好ましい。また必要に応じて、酸素による重合阻害を防 止するためにベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂 肪酸誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で感光層 の表面に偏在させてもよい。高級脂肪酸誘導体の添加量 は、全組成物の約0.5%~約10%が好ましい。

【0106】本発明の感光性樹脂組成物として光重合性 のものを用いて感光層とした平版印刷版は、その光重合 性感光層の上に、酸素による重合阻害を防止する目的 で、酸素遮断性保護層を設けることができる。 酸素遮 断性保護層に含まれる水溶性ビニル重合体としては、ポ リビニルアルコール、およびその部分エステル、エーテ ル、およびアセタール、またはそれらに必要な水溶性を 有せしめるような実質的量の未置換ビニルアルコール単 位を含有するその共重合体が挙げられる。ポリビニルア ルコールとしては、71~100%加水分解され、重合 度が300~2400の範囲のものが挙げられる。

【0107】具体的には株式会社クラレ製PVA-10 5, PVA-110, PVA-117, PVA-117 H, PVA-120, PVA-124, PVA-124H, PVA-CS, PVA-CST, PVA-HC, P VA-203, PVA-204, PVA-205, PV A-210, PVA-217, PVA-220, PVA -224, PVA-217EE, PVA-217E, P VA-220E, PVA-224E, PVA-405. PVA-420、PVA-613、L-8等があげられ 号)、チタノセンとキサンテン色素さらにアミノ基ある 50 る。上記の共重合体としては、88~100%加水分解

されたポリビニルアセテートクロロアセテートまたはプ ロピオネート、ポリビニルホルマールおよびポリビニル アセタール並びにそれらの共重合体が挙げられる。その 他有用な重合体としてはポリビニルピロリドン、ゼラチ ンおよびアラビアゴムが挙げられ、これらは単独また は、併用して用いても良い。

【0108】本発明の酸素遮断性保護層を塗布する際用 いる溶媒としては、純水が好ましいが、メタノール、エ タノールなどのアルコール類、アセトン、メチルエチル ケトンなどのケトン類を純水と混合しても良い。そして 10 塗布溶液中の固形分の濃度は1~20重量%が適当であ る。本発明の酸素遮断性保護層にはさらに塗布性を向上 させるための界面活性剤、皮膜の物性を改良するための 水溶性の可塑剤等の公知の添加剤を加えても良い。水溶 性の可塑剤としてはたとえばプロピオンアミド、シクロ ヘキサンジオール、グリセリン、ソルビトール等があ る。また、水溶性の(メタ)アクリル系ポリマーなどを 添加しても良い。酸素遮断性保護層の被覆量は乾燥後の 重量で約0.1/m²~約15/m²の範囲が適当である。より好 ましくは1.0/m²~約5.0/m²である。

【0109】本発明は上記のキノンジアジド、もしくは 酸分解性基で保護されたアルカリ可溶性基を有する化合 物を用いたポジ型PS版、光重合系を用いたネガ型PS版の ほかに次のタイプの平版印刷版材料にも同様に用いるこ とができる。

- (1) ジアゾ樹脂を用いたネガ型平版印刷版材料。
- (2) 光架橋型樹脂を用いたネガ型平版印刷版材料。
- (3) アルカリ可溶バインダー、酸発生剤、酸(熱)架橋 性化合物を含むネガ型のレーザー直描型平版印刷材料。
- (4) アルカリ可溶バインダー、熱分解性でありかつ分解 しない状態では該アルカリ可溶性バインダーの溶解性を 実質的に低下させる物質をさらに含むポジ型のレーザー 直描型平版印刷材料。

【0110】以下順次各例に使用する材料を詳しく説明 する。

(1) に使用するジアゾ樹脂としては、例えばジアゾジア リールアミンと活性カルボニル化合物との縮合物の塩に 代表されるジアゾ樹脂があり、感光性、水不溶性で有機 溶剤可溶性のものが好ましい。 特に好適なジアゾ樹脂 としては、例えば4-ジアゾジフェニルアミン、4-ジ 40 アゾー3-メチルジフェニルアミン、4-ジアゾー4′ ーメチルジフェニルアミン、4ージアゾー3′ーメチル ジフェニルアミン、4ージアゾー4′ーメトキシジフェ ニルアミン、4ージアゾー3ーメチルー4′ーエトキシ ジフェニルアミン、4-ジアゾー3-メトキシジフェニ ルアミン等とホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒ ド、アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド、4.4′-ビスーメトキシメチルジフェニルエーテル等との縮合物 の有機酸塩または無機酸塩である。

ルホン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、 キシレンスルホン酸、メシチレンスルホン酸、ドデシル ベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、プロピル ナフタレンスルホン酸、1-ナフトール-5-スルホン 酸、2-ニトロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼ ンスルホン酸、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンソフ ェノン-5-スルホン酸等が挙げられ、無機酸として は、ヘキサフルオロリン酸、テトラフルオロホウ酸、チ オシアン酸等が挙げられる。更に、特開昭54-301 21号公報に記載の主鎖がポリエステル基であるジアゾ 樹脂;特開昭61-273538号公報に記載の無水カ ルボン酸残基を有する重合体と、ヒドロキシル基を有す るジアゾ化合物を反応してなるジアゾ樹脂;ポリイソシ アネート化合物とヒドロキシル基を有するジアゾ化合物 を反応してなるジアゾ樹脂等も使用しうる。

【0112】これらのジアソ樹脂の使用量は、組成物の 固形分に対して0~40重量%の範囲が好ましく、また 必要に応じて、2種以上のジアゾ樹脂を併用してもよ い。またネガ型感光性樹脂組成物を調製する際には、通 20 常有機高分子結合剤を併用する。このような有機高分子 結合剤としては、例えば、アクリル樹脂、ポリアミド樹 脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリアセタール 樹脂、ポリスチレン樹脂、ノボラック樹脂等が挙げられ る。更に、性能向上のために、公知の添加剤、例えば、 熱重合防止剤、染料、顔料、可塑剤、安定性向上剤など を加えることができる。

【0113】好適な染料としては、例えば、クリスタル バイオレット、マラカイグリーン、ビクトリアブルー、 メチレンブルー、エチルバイオレット、ローダミンB等 の塩基性油溶性染料などが挙げられる。市販品として は、例えば、「ビクトリアピュアブルーBOH」 (保土 谷化学工業(株)社製)、「オイルブルー#603」 (オリエント化学工業(株)社製)等が挙げられる。顔 料としては、例えば、フタロシアニンブルー、フタロシ アニングリーン、ジオキサジンバイオレット、キナクリ ドンレッド等が挙げられる。

【0114】可塑剤としては、例えば、ジエチルフタレ ート、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレート、リ ン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、リン酸トリクレ ジル、リン酸トリ (2-クロロエチル)、クエン酸トリ ブチル等が挙げられる。更に公知の安定性向上剤とし て、例えば、リン酸、亜リン酸、シュウ酸、酒石酸、リ ンゴ酸、クエン酸、ジピコリン酸、ポリアクリル酸、ベ ンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸なども併用する ことができる。これら各種の添加剤の添加量は、その目 的によって異なるが、一般に、感光性樹脂組成物の固形 分の0~30重量%の範囲が好ましい。

【0115】(2)に使用する光架橋型樹脂としては、水 性アルカリ現像液に対して親和性を持つ光架橋型樹脂が 【0111】この際の有機酸としては、例えばメタンス 50 好ましく、例えば、特公昭54-15711号公報に記

載の桂皮酸基とカルボキシル基を有する共重合体:特開 昭60-165646号公報に記載のフェニレンジアク リル酸残基とカルボキシル基を有するポリエステル樹 脂;特開昭60-203630号に記載のフェニレンジ アクリル酸残基とフェノール性水酸基を有するポリエス テル樹脂;特公昭57-42858号に記載のフェニレ ンジアクリル酸残基とナトリウムイミノジスルホニル基 を有するポリエステル樹脂;特開昭59-208552 号に記載の側鎖にアジド基とカルボキシル基を有する重 ミド基を有する重合体等が使用できる。

【0116】(3) に使用するアルカリ可溶バインダー、 酸発生剤は先に述べたキノンジアジド、または酸分解性 基で保護されたアルカリ可溶性基を有する化合物を用い たポジ型PS版で使用した材料と同じものを使用すること ができる。酸(熱)架橋性化合物とは、酸の存在下で架 橋する化合物を指し、例えば、ヒドロキシメチル基、ア セトキシメチル基、若しくはアルコキシメチル基でポリ 置換されている芳香族化合物及び複素環化合物が挙げら れるが、その中でも好ましい例として、フェノール類と 20 アルデヒド類を塩基性条件下で縮合させた化合物が挙げ られる。前記の化合物のうち好ましいものとしては、例 えば、フェノールとホルムアルデヒドを前記のように塩 基性条件下で縮合させた化合物、同様にして、m-クレ ゾールとホルムアルデヒドから得られる化合物、ビスフ エノールAとホルムアルデヒドから得られる化合物、 4、4′ービスフェノールとホルムアルデヒドから得ら れる化合物、その他、GB第2、082、339号にレ ゾール樹脂として開示された化合物等が挙げられる。

【0117】これらの酸架橋性化合物は、重量平均分子*30

*量が500~100,000で数平均分子量が200~ 50,000のものが好ましい。他の好ましい例として は、EP-A第0, 212, 482号に開示されている アルコキシメチル又はオキシラニルメチル基で置換され た芳香族化合物、EP-A第0、133、216号、D E-A第3, 634, 671号、DE第3, 711、2 64号に開示された単量体及びオリゴマーメラミンーホ ルムアルデヒド縮合物並びに尿素ーホルムアルデヒド縮 合物、EP-A第0, 212, 482号に開示されたア 合体、特開平7-295212号に記載の側鎖にマレイ 10 ルコキシ置換化合物等がある。さらに他の好ましい例 は、例えば、少なくとも2個の遊離Nーヒドロキシメチ ル、N-アルコキシメチル又はN-アシルオキシメチル 基を有するメラミン-ホルムアルデヒド誘導体である。 このなかでは、Nーアルコキシメチル誘導体が特に好ま

> 【0118】また、低分子量又はオリゴマーシラノール は、ケイ素含有架橋剤として使用できる。これらの例 は、ジメチルー及びジフェニルーシランジオール、並び に既に予備縮合され且つこれらの単位を含有するオリゴ マーであり、例えば、EP-A第0, 377, 155号 に開示されたものを使用できる。アルコキシメチル基で ポリ置換された芳香族化合物及び複素環化合物のなかで は、ヒドロキシル基に隣接する位置にアルコキシメチル 基を有し、且つそのアルコキシメチル基のアルコキシ基 が炭素数18以下の化合物を好ましい例として挙げるこ とができ、特に好ましい例として、下記一般式 (B) ~ (E) の化合物を挙げることができる。

[0119] 【化20】

般式 (B)

$$L_8$$
 L_5 L_5 L_6 OH L_5 L_6 L_6 L_6 L_6 L_6 L_7 L_8 L_8

[0120]

$$L_1$$
 L_3 L_7 L_6 OH $-$ 般式 (D)

$$L_1$$
 L_6 OH L_5 一般式 (E)

【0121】式中 L_1 ~ L_8 は同じであっても異なってい 20 でもよく、メトキシメチル、エトキシメチル等のように 炭素数 18以下のアルコキシ基で置換された、アルコキシメチル基を示す。これらは架橋効率が高く、耐刷性を 向上させることができる点で好ましい。上記の熱により 架橋する化合物は、1種類のみで使用してもよいし、2 種類以上を組み合わせて使用してもよい。本発明に使用 される酸架橋性化合物は、平版印刷版材料の全固形分中、5~80重量%、好ましくは 10~75重量%、特に好ましくは 20~70重量%の添加量で用いられる。 酸架橋性化合物の添加量が 5重量%未満であると得られ 30 る平版印刷版材料の感光層の耐久性が悪化し、また、80重量%を越えると保存時の安定性の点で好ましくない。

【0122】(4)に使用するアルカリ可溶バインダーは 先に述べたキノンジアジドを用いたポジ型PS版で使用し た材料と同じものを使用することができる。熱分解性で ありかつ分解しない状態では該アルカリ可溶性バインダーの溶解性を実質的に低下させる物質としては、種々の オニウム塩、キノンジアジド化合物類等が、アルカリ可 溶性バインダーの溶解性を低下させることに優れてお り、好適に用いられる。オニウム塩としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム 塩、アンモニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩 等を挙げることができる。

【0123】本発明において用いられるオニウム塩として、好適なものとしては、例えば、S. I. Schlesinger、Photogr. Sci. Eng., I8,387 (1974)、T. S. Baletal., Polymer, 21,423 (1980)、特開平5-158230号公報等に記載のジアゾニウム

塩、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号、特開平3-140140号等に記載のアンモニウム塩、D.C.Necker et al.,Macromolecules,17,2468(1984)、C.S.Wen et al.,Teh,Proc.Conf.Rad.Curing ASIA,p478,Tokyo,Oct(1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Crivello et al.,Macromolecules,10

(6), 1307 (1977)、Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (1988)、欧州特許第104, 143号、米国特許第339,049号、同第410,201号、特開平2-150848号、特開平2-296514号等に記載のヨードニウム塩、

[0 1 2 4] J.V.Crivello et al., Polymer J. 17, 73 (1985), J. V. Crivello et al., J. Org. Chem., 43, 3055 (1978), W.R. Watt et al., J. Polymer Sci., Polymer C hem. Ed., 22, 1789(1984), J. V. Crivello et al., Poly mer Bull., 14,279(1985), J.V.Crivello et al., Macr omolecules, 14(5), 1141(1981), J. V. Crivello etal... J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17,2877(1979) 、欧州特許第370,693 号、米国特許第3,902,114号、 欧州特許第233,567 号、同297,443 号、同297,442 号。 米国特許第4,933,377 号、同410,201 号、同339,049 号、同4,760,013号、同4,734,444 号、同2,833,827 号、独国特許第2,904,626 号、同3,604,580号、同3,60 4,581 号等に記載のスルホニウム塩、J.V.Crivello et al., Macromolecules, 10(6), 1307(1977), J.V.Crivel lo et al., J. Polymer Sci., PolymerChem. Ed., 17, 10 50 47(1979) 等に記載のセレノニウム塩、C.S. Wen et al.,

Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478, Tokyo, Oc t(1988) 等に記載のアルソニウム塩等が挙げられる。

【0125】本発明においては、これらのうち特にジア ゾニウム塩が好ましい。また、特に好適なジアゾニウム 塩としては、特開平5-158230号公報に記載のも のが挙げられる。好適なキノンジアジド化合物類として は、oーキノンジアジド化合物を挙げることができる。

【0126】本発明に用いられる。-キノンジアジド化 合物は、少なくとも1個のo-キノンジアジド基を有す る化合物で、熱分解によりアルカリ可溶性を増すもので 10 あり、種々の構造の化合物を用いることができる。つま り、oーキノンジアジドは熱分解によりアルカリ可溶性 バインダーの溶解抑制能を失うことと、oーキノンジア ジド自身がアルカリ可溶性の物質に変化することの両方 の効果により、感材系の溶解性を助ける。本発明に用い られるo-キノンジアジド化合物としては、例えば、J . コーサー著「ライトーセンシティブ・システムズ」

(John Wiley & Sons. Inc.) 第339~352頁に記 載の化合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒド ロキシ化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させた 20 o-キノンジアジドのスルホン酸エステルまたはスルホ ン酸アミドが好適である。また、特公昭43-2840 3号公報に記載されているようなベンゾキノンー (1, 2) -ジアジドスルホン酸クロライドまたはナフトキノ ンー (1, 2) -ジアジド-5-スルホン酸クロライド とピロガロールーアセトン樹脂とのエステル、米国特許 第3,046,120 号および同第3,188,210 号等に記載されて いるベンゾキノンー(1,2)-ジアジドスルホン酸ク ロライドまたはナフトキノンー(1, 2) ージアジドー 5-スルホン酸クロライドとフェノールーホルムアルデ 30 ヒド樹脂とのエステルも好適に使用される。

【0127】さらにナフトキノンー(1,2)ージアジ ドー4ースルホン酸クロライドとフェノールーホルムア ルデヒド樹脂あるいはクレゾールーホルムアルデヒド樹 脂とのエステル、ナフトキノン- (1, 2) -ジアジド ー4ースルホン酸クロライドとピロガロール-アセトン 樹脂とのエステルも同様に好適に使用される。その他の 有用なoーキノンジアジド化合物としては、数多くの特 許関連の文献に報告があり知られている。例えば、特開 昭47-5303 号、特開昭48-63802号、特開昭48-63803号、 特開昭48-96575号、特開昭49-38701号、特開昭48-13354 号、特公昭41-11222号、特公昭45-9610 号、特公昭49-1 7481号、米国特許第2,797,213 号、同第3,454,400 号、 同第3,554,323 号、同第3,573,917 号、同第3,674,495 号、同第3,785,825 号、英国特許第1,277,602 号、同第 1,251,345 号、同第1,267,005 号、同第1,329,888 号、 同第1,330,932 号、ドイツ特許第854,890 号等の各文献 (明細書) 中に記載されているものを挙げることができ る。

合物の添加量は、好ましくは平版印刷版材料の全固形分 に対して1~50重量%、さらに好ましくは5~30重 量%、特に好ましくは10~30重量%の範囲である。 これらの化合物は単独で使用することができるが、数種 の混合物として使用してもよい。oーキノンジアジド化 合物の添加量が1重量%未満であると画像の記録性が悪 化し、一方、50重量%を超えると画像部の耐久性が劣 化したり感度が低下したりする。

【0129】オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化 ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレン スルホン酸、5-ニトロ-o-トルエンスルホン酸、5 ースルホサリチル酸、2,5-ジメチルベンゼンスルホ ン酸、2, 4, 6-トリメチルベンゼンスルホン酸、2 -ニトロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼンスル ホン酸、3-ブロモベンゼンスルホン酸、2-フルオロ カプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスル ホン酸、1-ナフトール-5-スルホン酸、2-メトキ シー4-ヒドロキシー5-ベンゾイルーベンゼンスルホ ン酸、およびパラトルエンスルホン酸等を挙げることが できる。これらの中でも特に、六フッ化リン酸、トリイ ソプロピルナフタレンスルホン酸や2,5-ジメチルベ ンゼンスルホン酸の如きアルキル芳香族スルホン酸が好 適である。oーキノンジアジド化合物以外の上記化合物 の添加量は、好ましくは平版印刷版材料の全固形分に対 して1~50重量%、さらに好ましくは5~30重量 %、特に好ましくは10~30重量%の範囲である。

【0130】その他本発明の組成物中には、画像のイン キ着肉性を向上させるための、疎水基を有する各種樹 脂、例えばオクチルフェノール・ホルムアルデヒド樹 脂、tーブチルフェノール・ホルムアルデヒド樹脂、t ーブチルフェノール・ベンズアルデヒド樹脂、ロジン変 性ノボラック樹脂、及びこれら変性ノボラック樹脂の。 ーナフトキノンジアジドスルホン酸エステル等;塗膜の 可撓性を改良するための可塑剤、例えばフタル酸ジブチ ル、フタル酸ジオクチル、ブチルグリコレート、リン酸 トリクレジル、アジピン酸ジオクチル等、種々の目的に 応じて各種添加剤を加えることができる。これらの添加 量は組成物全重量に対して、0.01~30重量%の範 囲が好ましい。

【0131】更にこれらの組成物中には、皮膜の耐摩耗 性を更に向上させるための公知の樹脂を添加できる。こ れらの樹脂としては、例えばポリビニルアセタール樹 脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、塩化ビニル樹 脂、ナイロン、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂等があ り、単独または混合して使用することができる。添加量 は組成物全重量に対して、2~40重量%の範囲が好ま しい。

【0132】また、本発明における感光性樹脂組成物中 には、現像のラチチュードを広げるために、特開昭62 【0128】本発明で使用されるoーキノンジアジド化 50 -251740号公報や、特開平4-68355号公報 に記載されているような非イオン性界面活性剤、特開昭 59-121044号公報、特開平4-13149号公報に記載されているような両性界面活性剤を添加することができる。非イオン性界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテ

ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルなどが挙げられ、両性界面活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチル 10グリシン塩酸塩、アモーゲンK(商品名、第一工業製薬(株)製、NーテトラデシルーN,Nーベタイン型)、2ーアルキルーNーカルボキシエチルーNーヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、レボン15(商品名、三洋化成(株)製、アルキルイミダゾリン系)などが挙げられる。上記非イオン性界面活性剤、両性界面活性剤の感光性樹脂組成物中に占める割合は0.05~15重量%が好ましく、より好ましくは、0.1~5重量%である。

【0133】塗布面質の向上:本発明における感光性樹 20 脂組成物中には、塗布面質を向上するための界面活性 剤、例えば、特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、全感光性樹脂組成物の0.001~1.0重量%であり、更に好ましくは0.005~0.5重量%である。

【0134】また本発明における感光性樹脂組成物中には黄色系染料、好ましくは417nmの吸光度が436nmの吸光度の70%以上ある黄色系染料を添加することができる。

【0135】本発明のフッ素系ポリマーを含んだ感光性 30 樹脂組成物から平版印刷版用感光材料を得る場合には、まずそれが適当な支持体上に設けられる。本発明のフッ素系ポリマーを含んだ感光性樹脂組成物は、下記の有機溶剤の単独あるいは混合したものに溶解または分散され、支持体に塗布され乾燥される。 有機溶剤としては、公知慣用のものがいずれも使用できるが、沸点40 $\mathbb{C}\sim200\mathbb{C}$ 、特に $60\mathbb{C}\sim160\mathbb{C}$ の範囲のものが、乾燥の際における有利さから選択される。勿論、本発明の界面活性剤が溶解するものを選択するのが良い。

【0136】有機溶剤としては、例えばメチルアルコール、エチルアルコール、n-またはイソープロピルアルコール、n-またはイソープチルアルコール、ジアセトンアルコール等のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルブチルケトン、メチルアミルケトン、メチルへキシルケトン、ジエチルケトン、ジイソブチルケトン、シクロへキサノン、メチルシクロへキサノン、アセチルアセトン等のケトン類、ベンゼン、トルエン、キシレン、シクロへキサン、メトキシベンゼン等の炭化水素類、エチルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート、n-またはイソープロピルアセテート

ーブチルアセテート、エチルブチルアセテート、ヘキシルアセテート等の酢酸エステル類、メチレンジクロライド、エチレンジクロライド、モノクロルベンゼン等のハロゲン化物、イソプロピルエーテル、nーブチルエーテル、ジオキサン、ジメチルジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類、

【0137】エチレングリコール、メチルセロソルブ メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブ、ジエ チルセロソルブ、セロソルブアセテート、ブチルセロソ ルプ、ブチルセロソルブアセテート、メトキシメトキシ エタノール、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ ングリコールメチルエチルエーテル、ジエチレングリコ ールジエチルエーテル、プロピレングリコール、プロピ レングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコ ールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコ ールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノエ チルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノブ チルエーテル、3-メチル-3-メトキシブタノール等 の多価アルコールとその誘導体、ジメチルスルホキシ ド、N, N-ジメチルホルムアミド等の特殊溶剤などが 単独あるいは混合して好適に使用される。そして、塗布 する組成物中の固形分の濃度は、2~50重量%とする のが適当である。

【0138】本発明の組成物の塗布方法としては、例えばロールコーティング、ディップコーティング、エアナイフコーティング、グラビアコーティング、グラビアオフセットコーティング、ホッパーコーティング、ブレードコーティング等の方法が用いられ、乾燥後の重量にして0.3~4.0g/m²が好ましい。塗布量が小さくなるにつれて画像を得るための露光量は小さくて済むが、膜強度は低下する。塗布量が大きくなるにつれ、露光量を必要とするが感光膜は強くなり、例えば、印刷版として用いた場合、印刷可能枚数の高い(高耐刷の)印刷版が得られる。

【0139】支持体上に塗布された感光性樹脂組成物の乾燥は、通常加熱された空気によって行われる。加熱は $30\% \sim 200\%$ 特に、 $40\% \sim 140\%$ の範囲が好適である。乾燥の温度は乾燥中一定に保たれる方法だけでなく段階的に上昇させる方法も実施し得る。また、乾燥風は除湿することによって好結果が得られる場合もある。加熱された空気は、塗布面に対し $0.1m/\psi \sim 30m/\psi$ 、特に $0.5m/\psi \sim 20m/\psi$ の割合で供給するのが好適である。

チルケトン、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノン、 【0140】マット層:上記のようにして設けられた感メチルシクロヘキサノン、アセチルアセトン等のケトン 光層の表面には、真空焼き枠を用いた密着露光の際の真類、ベンゼン、トルエン、キシレン、シクロヘキサン、 空引きの時間を短縮し、且つ焼きボケを防ぐため、マッメトキシベンゼン等の炭化水素類、エチルアセテート、 ト層を設けることが好ましい。具体的には、特開昭50nーまたはイソープロピルアセテート、nーまたはイソ 50 -125805号、特公昭57-6582号、同61-

28986号の各公報に記載されているようなマット層 を設ける方法、特公昭62-62337号公報に記載さ れているような固体粉末を熱融着させる方法などが挙げ られる。

【0141】感光性平版印刷版等に使用される支持体 は、寸度的に安定な板状物であり、これ迄印刷版の支持 体として使用されたものが含まれ、好適に使用すること ができる。かかる支持体としては、紙、プラスチックス (例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン など) がラミネートされた紙、例えばアルミニウム (ア ルミニウム合金も含む)、亜鉛、鉄、銅などのような金 属の板、例えば二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、 プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酪酸酢酸セ ルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレー ト、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポ リカーボネート、ポリビニルアセタールなどのようなプ ラスチックスのフイルム、上記のような金属がラミネー トもしくは蒸着された紙もしくはプラスチックフィルム などが含まれるが、特にアルミニウム板が好ましい。ア ルミニウム板には純アルミニウム板及びアルミニウム合 20 金板が含まれる。アルミニウム合金としては種々のもの が使用でき、例えばケイ素、銅、マンガン、マグネシウ ム、クロム、亜鉛、鉛、ビスマス、ニッケルなどの金属 とアルミニウムの合金が用いられる。これらの組成物 は、いくらかの鉄およびチタンに加えてその他無視し得 る程度の量の不純物をも含むものである。

【0142】支持体は、必要に応じて表面処理される。 例えば感光性平版印刷版の場合には、支持体の表面に、 親水化処理が施される。また金属、特にアルミニウムの 表面を有する支持体の場合には、砂目立て処理、ケイ酸 30 ソーダ、弗化ジルコニウム酸カリウム、リン酸塩等の水 溶液への浸漬処理、あるいは陽極酸化処理などの表面処 理がなされていることが好ましい。また、米国特許第 2,714,066号明細書に記載されているように、 砂目立てしたのちケイ酸ナトリウム水溶液に浸潰処理し たアルミニウム板、米国特許第3,181,461号明 細書に記載されているようにアルミニウム板を陽極酸化 処理を行った後にアルカリ金属ケイ酸塩の水溶液に浸漬 処理したものも好適に使用される。上記陽極酸化処理 は、例えば、リン酸、クロム酸、硫酸、ホウ酸等の無機 40 酸、若しくはシュウ酸、スルファミン酸等の有機酸また はこれらの塩の水溶液又は非水溶液の単独又は二種以上 を組み合わせた電解液中でアルミニウム板を陽極として 電流を流すことにより実施される。

【0143】また、米国特許第3,658,662号明 細書に記載されているようなシリケート電着も有効であ る。これらの親水化処理は、支持体の表面を親水性とす る為に施される以外に、その上に設けられる感光性樹脂 組成物との有害な反応を防ぐ為や、感光層との密着性を

砂目立てするに先立って、必要に応じて表面の圧延油を 除去すること及び清浄なアルミニウム面を表出させるた めにその表面の前処理を施しても良い。前者のために は、トリクレン等の溶剤、界面活性剤等が用いられてい る。又後者のためには水酸化ナトリウム、水酸化カリウ ム等のアルカリ・エッチング剤を用いる方法が広く行わ れている。

【0144】砂目立て方法としては、機械的、化学的お よび電気化学的な方法のいずれの方法も有効である。機 械的方法としては、ボール研磨法、ブラスト研磨法、軽 石のような研磨剤の水分散スラリーをナイロンブラシで 擦りつけるブラシ研磨法などがあり、化学的方法として は、特開昭54-31187号公報に記載されているよ うな鉱酸のアルミニウム塩の飽和水溶液に浸漬する方法 が適しており、電気化学的方法としては塩酸、硝酸また はこれらの組合せのような酸性電解液中で交流電解する 方法が好ましい。このような粗面化方法の内、特に特開 昭55-137993号公報に記載されているような機 械的粗面化と電気化学的粗面化を組合せた粗面化方法 は、感脂性画像の支持体への接着力が強いので好まし い。上記の如き方法による砂目立ては、アルミニウム板 の表面の中心線表面粗さ (Ra) が 0. 3~1. 0 μm となるような範囲で施されることが好ましい。このよう にして砂目立てされたアルミニウム板は必要に応じて水 洗および化学的にエッチングされる。

【0145】エッチング処理液は、通常アルミニウムを 溶解する塩基あるいは酸の水溶液より選ばれる。この場 合、エッチングされた表面に、エッチング液成分から誘 導されるアルミニウムと異なる被膜が形成されないもの でなければならない。好ましいエッチング剤を例示すれ ば、塩基性物質としては水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム、リン酸三ナトリウム、リン酸二ナトリウム、リン 酸三カリウム、リン酸二カリウム等;酸性物質としては 硫酸、過硫酸、リン酸、塩酸及びその塩等であるが、ア ルミニウムよりイオン化傾向の低い金属例えば亜鉛、ク ロム、コバルト、ニッケル、銅等の塩はエッチング表面 に不必要な被膜を形成するから好ましくない。これ等の エッチング剤は、使用濃度、温度の設定において、使用 するアルミニウムあるいは合金の溶解速度が浸漬時間1 分あたり O. 3グラムから 4 Og/m²になる様に行なわ れるのが最も好ましいが、これを上回るあるいは下回る ものであっても差支えない。

【0146】エッチングは上記エッチング液にアルミニ ウム板を浸漬したり、該アルミニウム板にエッチング液 を塗布すること等により行われ、エッチング量が0.5 ~10g/m²の範囲となるように処理されることが好ま しい。上記エッチング剤としては、そのエッチング速度 が早いという特長から塩基の水溶液を使用することが望 ましい。この場合、スマットが生成するので、通常デス 向上させる為に施されるものである。アルミニウム板を 50 マット処理される。デスマット処理に使用される酸は、

硝酸、硫酸、リン酸、クロム酸、フッ酸、ホウフッ化水 素酸等が用いられる。エッチング処理されたアルミニウ ム板は、必要により水洗及び陽極酸化される。陽極酸化 は、この分野で従来より行なわれている方法で行なうこ とができる。具体的には、硫酸、リン酸、クロム酸、シ ュウ酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホン酸等あるい はそれらの二種類以上を組み合せた水溶液又は非水溶液 中でアルミニウムに直流または交流の電流を流すと、ア ルミニウム支持体表面に陽極酸化被膜を形成させること ができる。

【0147】陽極酸化の処理条件は使用される電解液に よって種々変化するので一般には決定され得ないが一般 的には電解液の濃度が1~80重量%、液温5~70 ℃、電流密度 0. 5~60 アンペア/dm²、電圧 1~10 0 Ⅴ、電解時間30秒~50分の範囲が適当である。こ れらの陽極酸化処理の内でも、とくに英国特許第1,4 12,768号明細書に記載されている硫酸中で高電流 密度で陽極酸化する方法および米国特許第3、511, 661号明細書に記載されているリン酸を電解浴として 陽極酸化する方法が好ましい。上記のように粗面化さ れ、さらに陽極酸化されたアルミニウム板は、必要に応 じて親水化処理しても良く、その好ましい例としては米 国特許第2, 714, 066号及び同第3, 181, 4 61号に開示されているようなアルカリ金属シリケー ト、例えばケイ酸ナトリウム水溶液または特公昭36-22063号公報に開示されている弗化ジルコニウム酸 カリウムおよび米国特許第4,153,461号明細書 に開示されているようなポリビニルホスホン酸で処理す る方法がある。

【0148】有機下塗層;本発明の感光性平版印刷版に は感光層を塗設する前に有機下塗層を設けることが非画 像部の感光層残りを減らす上で好ましい。かかる有機下 **塗層に用いられる有機化合物としては例えば、カルボキ** シメチルセルロース、デキストリン、アラビアガム、2 ーアミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有するホス ホン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、 ナフチルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホ スホン酸、メチレンジホスホン酸およびエチレンジホス ホン酸などの有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフ エニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸および 40 グリセロリン酸などの有機リン酸、置換基を有してもよ いフェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アル キルホスフィン酸およびグリセロホスフィン酸などの有 機ホスフィン酸、グリシンやβーアラニンなどのアミノ 酸類、およびトリエタノールアミンの塩酸塩などのヒド ロキシル基を有するアミンの塩酸塩などから選ばれる が、二種以上混合して用いてもよい。

【0149】その他ポリ(pービニル安息香酸)など下 記一般式(F)で示される構造単位を分子中に有する高 を用いることができる。 [0150] 【化22】

一般式(F)

10

$$\begin{array}{c} R_1 \\ -(CH_2 - C) - \\ R_2 - (COOX)_n \end{array}$$
 (F)

【0151】前記一般式 (F) において、R1は水素原 子、ハロゲン原子またはアルキル基を表すが、好ましく は、水素原子、塩素原子、または炭素数1~4個のアル キル基を表す。特に好ましくは水素原子またはメチル基 を表す。R2とR3は各々独立して、水素原子、水酸基、 ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、芳香族 基、置換芳香族基、一OR₄、一COOR₅、一CONH R₆、-COR₇もしくは-CNを表すか、またはR₂と R₃が結合して環を形成しても良い。ここでR₄~R₇は 各々アルキル基または芳香族基を表す。より好ましいR 2とR3は、各々独立して、水素原子、水酸基、塩素原 子、炭素数1~4個のアルキル基、フェニル基、-OR 4, -COOR₅, -CONHR₆, -COR₇, -CNT あり、ここでR4~R7は炭素数1~4個のアルキル基ま たはフェニル基である。特に好ましいR2とR3は、各々 独立して、水素原子、水酸基、メチル基またはメトキシ 基である。

【0152】Xは水素原子、金属原子、NR₈R₉R₁₀R 11を表し、ここで、Rs~R11は、各々独立して、水素 原子、アルキル基、置換アルキル基、芳香族基、置換芳 香族基を表すか、またはR₈とR₉が結合して環を形成し ても良い。より好ましいXは、水素原子、一価の金属原 子、NR₈R₉R₁₀R₁₁であり、ここで、R₈~R₁₁は、 各々独立して、水素原子、炭素数1~4個のアルキル基 またはフェニル基である。特に好ましいXは、水素原 子、ナトリウム、カリウムまたはNR₈R₉R₁₀R₁₁を表 し、ここで、 $R_8 \sim R_{11}$ は、各々独立して、水素原子、 メチル基、エチル基を表す。nは1~3の整数を表す が、好ましくは1または2を表し、より好ましくは1を 表す。

【0153】この有機下途層は次のような方法で設ける ことができる。即ち、水またはメタノール、エタノー ル、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれら の混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアル ミニウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水または メタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有 機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を 溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸潰して上記有機 化合物を吸着させ、しかる後、水などによって洗浄、乾 燥して有機下途層を設ける方法である。前者の方法で 分子化合物群の中から選ばれる少なくとも1種の化合物 50 は、上記の有機化合物の0.005~10重量%の濃度

の溶液を種々の方法で塗布できる。例えば、バーコータ 一塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布などい ずれの方法を用いてもよい。また、後者の方法では、溶 液の濃度は0.01~20重量%、好ましくは0.05 ~5 重量%であり、浸漬温度は20~90℃、好ましく は25~50℃であり、浸漬時間は0.1秒~20分、 好ましくは2秒~1分である。

【0154】これに用いる溶液は、アンモニア、トリエ チルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物質や、塩 酸、リン酸などの酸性物質により p Hを調節し、p H 1 ~12の範囲で使用することもできる。また、感光性平 版印刷版の調子再現性改良のために黄色染料を添加する こともできる。さらにこの溶液には、下記一般式(a) で示される化合物を添加することもできる。

一般式(a)

 $(HO)_m - R_1 - (COOH)_n$

但し、R1は置換基を有してもよい炭素数14以下のア リーレン基を表し、m, nは独立して1から3の整数を 表す。上記一般式(a)で示される化合物の具体的な例 として、3-ヒドロキシ安息香酸、4-ヒドロキシ安息 20 香酸、サリチル酸、1-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸、 2-ヒドロキシ-1-ナフトエ酸、2-ヒドロキシ-3 ーナフトエ酸、2, 4-ジヒドロキシ安息香酸、10-ヒドロキシー9ーアントラセンカルボン酸などが挙げら れる。有機下塗層の乾燥後の被覆量は、1~100mg/ m^2 が適当であり、好ましくは2~70 mg/m^2 である。上 記の被覆量が2mg/m²より少ないと十分な耐刷性能が得 られない。また、100mg/m²より大きくても同様であ る。

【0155】バックコート;支持体の裏面には、必要に 30 応じてバックコートが設けられる。かかるバックコート としては特開平5-45885号公報記載の有機高分子 化合物および特開平6-35174号公報記載の有機ま たは無機金属化合物を加水分解および重縮合させて得ら れる金属酸化物からなる被覆層が好ましく用いられる。 これらの被覆層のうち、Si(OCH₃)₄、Si(OC₂H₅) 4、Si(OC₃H₇)₄、Si(OC₄H₉)₄などのケイ素の アルコキシ化合物が安価で入手し易く、それから得られ る金属酸化物の被覆層が耐現像液に優れており特に好ま しい。

【0156】上記のようにして作成された平版印刷版 は、通常、像露光、現像処理を施される。像露光に用い られる活性光線の光源としては、例えば、水銀灯、メタ ルハライドランプ、キセノンランプ、ケミカルランプ、 カーボンアーク灯等がある。放射線としては、電子線、 X線、イオンビーム、遠赤外線などがある。またg線、 i線、Deep-UV光、高密度エネルギービーム(レ ーザービーム)も使用される。レーザービームとしては ヘリウム・ネオンレーザー、アルゴンレーザー、クリプ

エキシマレーザー等が挙げられる。またレーザー直描型 印刷版においては近赤外から赤外領域に発光波長を持つ 光源が好ましく、固体レーザ、半導体レーザが特に好ま LVZ

【0157】本発明の感光性樹脂組成物を用いる平版印 刷版の現像液として好ましいものは、(a)非還元糖か ら選ばれる少なくとも一種の糖類および(b)少なくと も一種の塩基を含有し、p Hが 9.0~13.5の範囲 にある現像液である。以下この現像液について詳しく説 明する。なお、本明細書中において、特にことわりのな い限り、現像液とは現像開始液(狭義の現像液)と現像 補充液とを意味する。

【0158】この現像液は、その主成分が、非還元糖か ら選ばれる少なくとも一つの化合物と、少なくとも一種 の塩基からなり、液のpHが9.0~13.5の範囲で あることが好ましい。かかる非還元糖とは、遊離のアル デヒド基やケトン基を持たず、還元性を示さない糖類で あり、還元基同士の結合したトレハロース型少糖類、糖 類の還元基と非糖類が結合した配糖体および糖類に水素 添加して還元した糖アルコールに分類され、何れも好適 に用いられる。トレハロース型少糖類には、サッカロー スやトレハロースがあり、配糖体としては、アルキル配 糖体、フェノール配糖体、カラシ油配糖体などが挙げら れる。また糖アルコールとしてはD、Lーアラビット リビット、キシリット、D, L-ソルビット、D, L-マンニット、D、Lーイジット、D、Lータリット、ズ リシットおよびアロズルシットなどが挙げられる。更に 二糖類の水素添加で得られるマルチトールおよびオリゴ 糖の水素添加で得られる還元体(還元水あめ)が好適に 用いられる。これらの中で特に好ましい非還元糖は糖ア ルコールとサッカロースであり、特にD-ソルビット、 サッカロース、還元水あめが適度な p H 領域に緩衝作用 があることと、低価格であることで好ましい。

【0159】これらの非還元糖は、単独もしくは二種以 上を組み合わせて使用でき、それらの現像液中に占める 割合は0.1~30重量%が好ましく、更に好ましく は、1~20重量%である。この範囲以下では十分な緩 衝作用が得られず、またこの範囲以上の濃度では、高濃 縮化し難く、また原価アップの問題が出てくる。尚、還 元糖を塩基と組み合わせて使用した場合、経時的に褐色 に変色し、pHも徐々に下がり、よって現像性が低下す るという問題点がある。

【0160】非還元糖に組み合わせる塩基としては従来 より知られているアルカリ剤が使用できる。例えば、水 酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、リ ン酸三ナトリウム、リン酸三カリウム、リン酸三アンモ ニウム、リン酸二ナトリウム、リン酸二カリウム、リン 酸二アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭 酸アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウ トンレーザー、ヘリウム・カドミウムレーザー、KrF 50 ム、炭酸水素アンモニウム、ホウ酸ナトリウム、ホウ酸 カリウム、ホウ酸アンモニウムなどの無機アルカリ剤が 挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルアミ ン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルア ミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジ イソプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、nーブ チルアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミ ン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミ ン、ジイソプロパノールアミン、エチレンイミン、エチ レンジアミン、ピリジンなどの有機アルカリ剤も用いら れる。

【0161】これらのアルカリ剤は単独もしくは二種以上を組み合わせて用いられる。これらの中で好ましいのは水酸化ナトリウム、水酸化カリウムである、その理由は、非還元糖に対するこれらの量を調整することにより広いp H領域でp H調整が可能となるためである。また、リン酸三ナトリウム、リン酸三カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどもそれ自身に緩衝作用があるので好ましい。これらのアルカリ剤は現像液のp Hをp Hをp 10~13.5の範囲になるように添加され、その添加量は所望のp H、非還元糖の種類と添加量によって決 20 められるが、より好ましいp H範囲は10.0~13.2である。

【0162】現像液には更に、糖類以外の弱酸と強塩基からなるアルカリ性緩衝液が併用できる。かかる緩衝液として用いられる弱酸としては、解離定数(pKa)が10.0~13.2のものが好ましい。このような弱酸としては、Pergamon Press社発行のIONISATION CONSTANTS OF ORGANIC ACIDS IN AQUEOUS SOLUTIONなどに記載されているものから選ばれ、例えば2,2,3,3-テトラフルオロプロパノールー1(pKa12.74)、トリフルオロエタノール(同12.37)、トリクロロエタノール(同12.24)などのアルコール類、ピリジンー2ーアルデヒド(同12.68)、ピリジンー4ーアルデヒド(同12.05)などのアルデヒド類、サリチル酸(同13.0)、3ーヒドロキシー2ーナフトエ酸(同12.84)、カテコール(同12.6)、没食子酸(同12.4)、スルホサリチル酸(同11.

- 7)、3,4-ジヒドロキシスルホン酸(同12.
- 2)、3,4-ジヒドロキシ安息香酸(同11.94)、1,2、4-トリヒドロキシベンゼン(同11.82)、ハイドロキノン(同11.56)、ピロガロール(同11.34)、o-クレゾール(同10.33)、レゾルシノール(同11.27)、p-クレゾール(同10.27)、m-クレゾール(同10.09)などのフェノール性水酸基を有する化合物、

【 0 1 6 3 】 2 ー ブタノンオキシム (同 1 2 . 4 5) 、 アセトキシム (同 1 2 . 4 2) 、 1 . 2 ー シクロヘプタ ンジオンジオキシム (同 1 2 . 3) 、 2 ー ヒドロキシベ ンズアルデヒドオキシム (同 1 2 . 1 0) 、 ジメチルグ リオキシム (同 1 1 . 9) 、 エタンジアミドジオキシム 50 (同11.37)、アセトフェノンオキシム(同11.35)などのオキシム類、アデノシン(同12.56)、イノシン(同12.5)、グアニン(同12.3)、シトシン(同12.2)、ヒポキサンチン(同12.2)、シトシン(同12.2)などの核酸関連物質、他に、ジエチルアミノメチルホスホン酸(同12.32)、1-アミノー3、3、3-トリフルオロ安息香酸(同12.29)、イソプロピリデンジホスホン酸(同12.10)、1、1-エチリデンジホスホン酸(同11.54)、1、1-エチリデンジホスホン酸1-ヒドロキシ(同11.52)、ベンズイミダゾール(同12.86)、チオベンズアミド(同12.8)、ピコリンチオアミド(同12.55)、バルビツル酸(同12.5)などの弱酸が挙げられる。

10

30

【0164】これらの弱酸の中で好ましいのは、スルホサリチル酸、サリチル酸である。これらの弱酸に組み合わせる塩基としては、水酸化ナトリウム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチウムが好適に用いられる。これらのアルカリ剤は単独もしくは二種以上を組み合わせて用いられる。上記の各種アルカリ剤は濃度および組み合わせによりpHを好ましい範囲内に調整して使用される。

【0165】現像液には、現像性の促進や現像カスの分散および印刷版画像部の親インキ性を高める目的で必要に応じて種々界面活性剤や有機溶剤を添加できる。好ましい界面活性剤としては、アニオン系、カチオン系、ノニオン系および両性界面活性剤が挙げられる。

【0166】界面活性剤の好ましい例としては、ポリオ キシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレン アルキルフェニルエーテル類、ポリオキシエチレンポリ スチリルフェニルエーテル類、ポリオキシエチレンポリ オキシプロピレンアルキルエーテル類、グリセリン脂肪 酸部分エステル類、ソルビタン脂肪酸部分エステル類、 ペンタエリスリトール脂肪酸部分エステル類、プロピレ ングリコールモノ脂肪酸エステル類、しょ糖脂肪酸部分 エステル類、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸部分 エステル類、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸部 分エステル類、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル 類、ポリグリセリン脂肪酸部分エステル類、ポリオキシ エチレン化ひまし油類、ポリオキシエチレングリセリン 脂肪酸部分エステル類、脂肪酸ジエタノールアミド類、 N, N-ビス-2-ヒドロキシアルキルアミン類、ポリ オキシエチレンアルキルアミン、トリエタノールアミン 脂肪酸エステル、トリアルキルアミンオキシドなどの非 イオン性界面活性剤、

【0167】脂肪酸塩類、アビエチン酸塩類、ヒドロキシアルカンスルホン酸塩類、アルカンスルホン酸塩類、ジアルキルスルホ琥珀酸エステル塩類、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類、分岐鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類、アルキルナフタレンスルホン酸塩類、アルキ

ルフェノキシポリオキシエチレンプロピルスルホン酸塩 類、ポリオキシエチレンアルキルスルホフェニルエーテ ル塩類、NーメチルーNーオレイルタウリンナトリウム 塩、N-アルキルスルホ琥珀酸モノアミドニナトリウム 塩、石油スルホン酸塩類、硫酸化牛脂油、脂肪酸アルキ ルエステルの硫酸エステル塩類、アルキル硫酸エステル 塩類、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステ ル塩類、脂肪酸モノグリセリド硫酸エステル塩類、ポリ オキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸エステル 塩類、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル硫 10 酸エステル塩類、アルキルリン酸エステル塩類、ポリオ キシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル塩類、ポ リオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸エス テル塩類、スチレン/無水マレイン酸共重合物の部分酸 化物類、オレフィン/無水マレイン酸共重合物の部分酸 化物類、

【0168】ナフタレンスルホン酸塩ホルマリン縮合物類などのアニオン界面活性剤、アルキルアミン塩類、テトラブチルアンモニウムブロミド等の第四級アンモニウム塩類、ポリオキシエチレンアルキルアミン塩類、ポリエチレンポリアミン誘導体などのカチオン性界面活性剤、カルボキシベタイン類、アミノカルボン酸類、スルホベタイン類、アミノ硫酸エステル類、イミダゾリン類などの両性界面活性剤が挙げられる。以上挙げた界面活性剤の中でポリオキシエチレンとあるものは、ポリオキシメチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシブチレンなどのポリオキシアルキレンに読み替えることもでき、それらの界面活性剤もまた包含される。

【0169】更に好ましい界面活性剤は分子内にパーフ ルオロアルキル基を含有するフッ素系の界面活性剤であ る。かかるフッ素系界面活性剤としては、パーフルオロ アルキルカルボン酸塩、パーフルオロアルキルスルホン 酸塩、パーフルオロアルキルリン酸エステルなどのアニ オン型、パーフルオロアルキルベタインなどの両性型、 パーフルオロアルキルトリメチルアンモニウム塩などの カチオン型およびパーフルオロアルキルアミンオキサイ ド、パーフルオロアルキルエチレンオキシド付加物、パ ーフルオロアルキル基および親水性基含有オリゴマー、 パーフルオロアルキル基および親油性基含有オリゴマ ー、パーフルオロアルキル基、親水性基および親油性基 含有オリゴマー、パーフルオロアルキル基および親油性 基含有ウレタンなどの非イオン型が挙げられる。上記の 界面活性剤は、単独もしくは2種以上を組み合わせて使 用することができ、現像液中に0.001~10重量 %、より好ましくは0.01~5重量%の範囲で添加さ れる。

【0170】現像液には、種々の現像安定化剤を用いることができる。それらの好ましい例として、特開平6-282079号公報記載の糖アルコールのポリエチレングリコール付加物、テトラブチルアンモニウムヒドロキ 50

シドなどのテトラアルキルアンモニウム塩、テトラブチルホスホニウムブロマイドなどのホスホニウム塩およびジフェニルヨードニウムクロライドなどのヨードニウム塩が好ましい例として挙げられる。更には、特開昭50~51324号公報記載のアニオン界面活性剤または両性界面活性剤、また特開昭55~95946号公報記載の水溶性カチオニックポリマー、特開昭56~142528号公報に記載されている水溶性の両性高分子電解質を挙げることができる。

【0171】更に、特開昭59-84241号公報のアルキレングリコールが付加された有機ホウ素化合物、特

開昭60-111246号公報記載のポリオキシエチレ ン・ポリオキシプロピレンブロック重合型の水溶性界面 活性剤、特開昭60-129750号公報のポリオキシ エチレン・ポリオキシプロピレンを置換したアルキレン ジアミン化合物、特開昭61-215554号公報記載 の重量平均分子量300以上のポリエチレングリコー ル、特開昭63-175858号公報のカチオン性基を 有する含フッ素界面活性剤、特開平2-39157号公 報の酸またはアルコールに4モル以上のエチレンオキシ ドを付加して得られる水溶性エチレンオキシド付加化合 物と、水溶性ポリアルキレン化合物などが挙げられる。 【0172】現像液には更に必要により有機溶剤が加え られる。かかる有機溶剤としては、水に対する溶解度が 約10重量%以下のものが適しており、好ましくは5重 量%以下のものから選ばれる。例えば、1-フェニルエ タノール、2ーフェニルエタノール、3ーフェニルー1 ープロパノール、4ーフェニルー1ーブタノール、4ー フェニルー2ープタノール、2ーフェニルー1ーブタノ ール、2-フェノキシエタノール、2-ベンジルオキシ エタノール、oーメトキシベンジルアルコール、mーメ トキシベンジルアルコール、pーメトキシベンジルアル コール、ベンジルアルコール、シクロヘキサノール、2 ーメチルシクロヘキサノール、3-メチルシクロヘキサ ノールおよび4-メチルシクロヘキサノール、N-フェ ニルエタノールアミンおよびN-フェニルジエタノール アミンなどを挙げることができる。有機溶剤の含有量は 使用液の総重量に対して 0.1~5重量%である。その 使用量は界面活性剤の使用量と密接な関係があり、有機 溶剤の量が増すにつれ、界面活性剤の量は増加させるこ とが好ましい。これは界面活性剤の量が少なく、有機溶 剤の量を多く用いると有機溶剤が完全に溶解せず、従っ て、良好な現像性の確保が期待できなくなるからであ

【0173】現像液には更に還元剤を加えることができる。これは印刷版の汚れを防止するものであり、特に感光性ジアゾニウム塩化合物を含むネガ型感光性平版印刷版を現像する際に有効である、好ましい有機還元剤としては、チオサリチル酸、ハイドロキノン、メトール、メトキシキノン、レゾルシン、2ーメチルレゾルシンなど

のフェノール化合物、フェニレンジアミン、フェニルヒドラジンなどのアミン化合物が挙げられる。更に好ましい無機の還元剤としては、亜硫酸、亜硫酸水素酸、亜リン酸、亜リン酸水素酸、亜リン酸二水素酸、チオ硫酸および亜ジチオン酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩などを挙げることができる。これらの還元剤のうち汚れ防止効果が特に優れているのは亜硫酸塩である。これらの還元剤は使用時の現像液に対して好ましくは、0.05~5重量%の範囲で含有される。

【0174】現像液には更に有機カルボン酸を加えるこ ともできる。好ましい有機カルボン酸は炭素原子数6~ 20の脂肪族カルボン酸および芳香族カルボン酸であ る。脂肪族カルボン酸の具体的な例としては、カプロン 酸、エナンチル酸、カプリル酸、ラウリン酸、ミリスチ ン酸、パルミチン酸およびステアリン酸などがあり、特 に好ましいのは炭素数8~12のアルカン酸である。ま た炭素鎖中に二重結合を有する不飽和脂肪酸でも、枝分 かれした炭素鎖のものでもよい。芳香族カルボン酸とし てはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環などに 20 カルボキシル基が置換された化合物で、具体的には、o ークロロ安息香酸、pークロロ安息香酸、oーヒドロキ シ安息香酸、pーヒドロキシ安息香酸、oーアミノ安息 香酸、p-アミノ安息香酸、2, 4-ジヒドロシ安息香 酸、2,5ージヒドロキシ安息香酸、2,6ージヒドロ キシ安息香酸、2、3-ジヒドロキシ安息香酸、3、5 ージヒドロキシ安息香酸、没食子酸、1-ヒドロキシー 2-ナフトエ酸、3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸、2 ーヒドロキシー1ーナフトエ酸、1ーナフトエ酸、2ー ナフトエ酸などがあるがヒドロキシナフトエ酸は特に有 30 効である。

【0175】上記脂肪族および芳香族カルボン酸は水溶性を高めるためにナトリウム塩やカリウム塩またはアンモニウム塩として用いるのが好ましい。本発明で用いる現像液の有機カルボン酸の含有量は格別な制限はないが、0.1重量%より低いと効果が十分でなく、また10重量%以上ではそれ以上の効果の改善が計れないばかりか、別の添加剤を併用する時に溶解を妨げることがある。従って、好ましい添加量は使用時の現像液に対して0.1~10重量%であり、より好ましくは0.5~440重量%である。

【0176】現像液には、更に必要に応じて、防腐剤、 着色剤、増粘剤、消泡剤および硬水軟化剤などを含有させることもできる。硬水軟化剤としては例えば、ポリリン酸およびそのナトリウム塩、カリウム塩およびアンモニウム塩、エチレンジアミンテトラ酢酸、ジエチレントリアミンペンタ酢酸、トリエチレンテトラミンヘキサ酢酸、ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸、ニトリロトリ酢酸、1、2-ジアミノシクロヘキサンテトラ酢酸および1、3-ジアミノ-2-プロパノールテトラ 50

酢酸などのアミノポリカルボン酸およびそれらのナトリウム塩、カリウム塩およびアンモニウム塩、アミノトリ(メチレンホスホン酸)、エチレンジアミンテトラ(メチレンホスホン酸)、ジエチレントリアミンペンタ(メチレンホスホン酸)、トリエチレンテトラミンヘキサ(メチレンホスホン酸)、ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ(メチレンホスホン酸)および1ーヒドロキシタエンー1、1ージホスホン酸やそれらのナトリウム塩、カリウム塩およびアンモニウム塩を挙げることがで10きる。

【0177】このような硬水軟化剤はそのキレート化と使用される硬水の硬度および硬水の量によって最適値が変化するが、一般的な使用量を示せば、使用時の現像液に0.01~5重量%、より好ましくは0.01~0.5重量%の範囲である。この範囲より少ない添加量では所期の目的が十分に達成されず、添加量がこの範囲より多い場合は、色抜けなど、画像部への悪影響がでてくる。現像液の残余の成分は水である。現像液は、使用時よりも水の含有量を少なくした濃縮液としておき、使用時に水で希釈するようにしておくことが運搬上有利である。この場合の濃縮度は、各成分が分離や析出を起こさない程度が適当である。

【0178】本発明の感光性樹脂組成物を用いる平版印 刷版の現像液としてはまた、特開平6-282079号 公報記載の現像液も使用できる。これは、SiO2/M2 O (Mはアルカリ金属を示す) のモル比が 0.5~2. 0の珪酸アルカリ金属塩と、水酸基を4以上有する糖ア ルコールに5モル以上のエチレンオキシドを付加して得 られる水溶性エチレンオキシド付加化合物を含有する現 像液である。糖アルコールは糖のアルデヒド基およびケ トン基を還元してそれぞれ第一、第二アルコール基とし たものに相当する多価アルコールである。糖アルコール の貝体的な例としては、D、Lートレイット、エリトリ ット、D、Lーアラビット、リビット、キシリット、 D, L-ソルビット、D, L-マンニット、D, L-イ ジット、D、Lータリット、ズルシット、アロズルシッ トなどであり、更に糖アルコールを縮合したジ、トリ、 テトラ、ペンタおよびヘキサグリセリンなども挙げられ る。上記水溶性エチレンオキシド付加化合物は上記糖ア ルコール1モルに対し5モル以上のエチレンオキシドを 付加することにより得られる。さらにエチレンオキシド 付加化合物には必要に応じてプロピレンオキシドを溶解 性が許容できる範囲でブロック共重合させてもよい。こ れらのエチレンオキシド付加化合物は単独もしくは二種 以上を組み合わせて用いてもよい。これらの水溶性エチ レンオキシド付加化合物の添加量は現像液(使用液)に 対して0.001~5重量%が適しており、より好まし くは0.001~2重量%である。

【0179】この現像液にはさらに、現像性の促進や現像カスの分散および印刷版画像部の親インキ性を高める

目的で必要に応じて、前述の種々の界面活性剤や有機溶剤を添加できる。

【0180】かかる組成の現像液で現像処理されたPS版は水洗水、界面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体等を主成分とするフィニッシャーや保護ガム液で後処理を施される。本発明のPS版の後処理にはこれらの処理を種々組み合わせて用いることができる。

【0181】近年、型版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、PS版用の自動現像機が広く用 10 いられている。この自動現像機は、一般に現像部と後処理部からなり、PS版を搬送する装置と、各処理液槽およびスプレー装置からなり、露光済みのPS版を水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノズルから吹き付けて現像および後処理するものである。また、最近は処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロールなどによってPS版を浸漬搬送させて現像処理する方法や、現像後一定量の少量の水洗水を版面に供給して水洗し、その廃水を現像液原液の希釈水としで再利用する方法も知られている。 20

【0182】このような自動処理においては、各処理液に処理量や稼動時間等に応じてそれぞれの補充液を補充しながら処理することができる。また、実質的に未使用の処理液で処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。このような処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機に掛けられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0183]

【実施例】以下本発明を合成例および実施例に基づいて 更に説明する。ただし本発明はこれらの実施例によって 30 限定されるものではない。

合成例1

2-(パーフルオロオクチル) エチルアクリレート1 5.5g、具体例モノマーM-1 13.9g、ラウリルメタアクリレート7.62gおよびテトラヒドロフラン63.14gを300mlの3ロフラスコに取り窒素気流下撹拌しながら65 $^{\circ}$ Cに保った。2.2'-アゾビス(2.4-ジメチルバレロニトリル)を1.44g加え撹拌を続けた。4時間後68 $^{\circ}$ まで昇温し1時間保った。反応終了後、室温まで冷却し、反応液を400ml 40中のメタノール中に注いだ。析出した固体をろ過し、乾燥した。収量30g、GPCによりこの固体は重量平均分子量2.0万の高分子化合物であった。

【0184】合成例2~5

合成例1と同様の方法にして第1表に示したポリマーを 合成した。

[0185]

【表1】

66 1. 表

合成例	ポリマー名	重量平均分子量
1	P - 1	20, 000
2	P - 2	22, 000
3	P - 3	18, 000
4	P - 7	25, 000
5	P - 1 2	30, 000

【0186】 [実施例1~4、比較例1]

(下記実施例におけるパーセントは、他に指定のない限り、すべて重量%である。)

厚さ0.24mmのJIS A 1050アルミニウム板 を、平均粒径約2. 1 μ mのパミストンと水の懸濁液を アルミニウム表面に供給しながら、以下に示す回転ナイ ロンブラシにより、ブラシグレイニング処理した。第1 ブラシは毛長100mm、毛径0.95mm、植毛密度70 20 本/cm²であり、第2ブラシは毛長80mm、毛径0.29 5 mm、植毛密度 6 7 0 本/cm²であった。ブラシロールの 回転はいずれも250rpmであった。ブラシグレイニン グにひき続きよく水洗した後、10%水酸化ナトリウム に60℃で25秒間浸漬してエッチングし、さらに流水 で水洗後20%硝酸で中和洗浄、水洗した。これらを、 V_A=12.7 Vの条件下で正弦波の交番波形電流を用 いて、1%硝酸水溶液中で160クローン/dm²の陽極時 電気量で電解粗面化処理を行った。その表面粗さを測定 したところ、0. 79μm(R_s表示)であった。引き 続いて、1%水酸化ナトリウム水溶液に40℃、30秒 間浸漬後、30%の硫酸水溶液中に浸漬し、60℃で4 0秒間デスマット処理した後、20%硫酸水溶液中、電 流密度 2 A/dm²において 1. 6 g/m²の酸化皮膜重量に なるように直流で陽極酸化し、基板を調整した。

【0187】このように処理された基板の表面に下記組成の下塗り液(A)を塗布し80 \mathbb{C} 、30 秒間乾燥した。乾燥後の被覆量は10 mg/m² であった。

下塗り液(A)

β-アラニン0.10 gメタノール40 g純水60 g

[0188]

第 2 表 〔感光液〕

1, 2 - ジアゾナフトキノン - 5 - スルホニルクロリドと ピロガロールーアセトン樹脂とのエステル化物 (米国特許第3, 635、709号明細書の実施例1に 記載されているもの)	0.8 g
クレゾールーホルムアルデヒドノポラック樹脂 (メタ、パラ比:6 対 4 、重量平均分子量8000)	1.5 g
フェノールーホルムアルデヒドノボラック樹脂 (重量平均分子量1. 5万)	0.3 g
ポリ (N- (p-アミノスルホニルフェニル) アクリルア ミド-コーノルマルブチルアクリレート-コージエチレ ングリコールモノメチルエーテルメタクリレート] (各モノマーのモル比は順に40:40:20、重量平均 分子量40、000、数平均分子量20、000)	0.2 g
p - ノルマルオクチルフェノールーホルムアルデヒド樹脂 (米国特許第4, 123, 279号明細書に記載されて いるもの)	0.02 g
ナフトキノンジアジドー1,2-ジアジド-4-スルホン 酸クロライド	0. 01 g
テトラヒドロ無水フタル酸	0.02 g
安息香酸	0.02 g
ピロガロール	0.05 g
4 - (p-N, N-ビス (エトキシカルボニルメチル) アミノフェニル) -2, 6-ビス (トリクロロメチル)・s-トリアジン	0.07 g
ピクトリアピュアーブルーBOH [保土谷化学(株) 製]の 対アニオンを 1 - ナフタレンスルホン酸に変えた契料	0.045g
F 1 7 6 P F	0.01 g
フッ素系ポリマー (第3表参照)	0.1 g
MEK/1-メトキシー2ープロパメール = 1 5 g/1 0 g	

【0189】このようにして作成した感光性平版印刷版 を以下の方法で評価した。感度は富士写真フィルム (株) 製ステップウエッジ (各段の濃度差が 0.15) を通して、1mの距離から3kWのメタルハライドラン 30 プにより1分間露光を行った後、富士写真フィルム (株) 製PSプロッセッサー900Vを用いて、30℃ 12秒間、SiO₂ / K₂ Oのモル比が1.16、Si O2 濃度が1. 4%の水溶液で現像し、クリアーの段数 で表わした。この段数が高い程感度が高いことを示す。 階調は、上述の感度評価したサンプルのクリアー段数と ベタ段数の差を表わした。この値が低い程硬調であるこ とを示す。現像許容性は、上述の現像液を基準にして、 p Hを上下に 0. 2 増減させた液を用いた以外は上述の 感度と同一な露光、現像を行い、pHによるベタ段数の 40 変化を表わした。この値が小さい程現像許容性は良好で あることを示す。これらの結果を第4表に示す。

[0190]

【表3】

第 3 麥

	フッ素系ポリマー
実施例1	P - 1
実施例2	P – 2
実施例3	P 3
実施例4	P – 7
比較例1	添加なし

添加量は固形分で O.lg

【0191】 【表4】

第 4 表

	フッ素系ポリマー	感度	階調	現像許容性
実施例1	P - 1	5. 75	5.0	5
実施例 2	P - 2	6.0	5.0	5
実施例3	P 3	5. 75	4. 5	5
実施例4	P – 7	6. 0	5. 0	7
比較例1	添加なし	5. 75	6. 5	8

【0192】第4表からも分かるように、実施例1~4 は、感度を低下させることなく、硬調化し、かつ現像許 容性も良好である。

【0193】 [実施例5~9、比較例2] 厚さ0.30 mmの材質1Sのアルミニウム板を8号ナイロンブラシと800メッシュのパミストンの水懸濁液を用い、その表面を砂目立てした後、よく水で洗浄した。10%水酸化ナトリウムに70℃で60秒間浸漬してエッチングし 20た後、流水で水洗後、20%HNO。で中和洗浄、水洗した。これを $V_A=12$.7Vの条件下で正弦波の交番波形電流を用いて1%硝酸水溶液中で300クーロン/d n^2 の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。その表面粗さを測定したところ 0.45μ m(Ra表示)であ*

Si(OC₂H₅)₄

3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン

85%リン酸水溶液

イオン交換水

メタノール

【0195】その溶液を三ロフラスコに移し、還流冷却器を取り付け三ロフラスコを室温のオイルバスに浸した。三ロフラスコの内容物をマグネティックスターラーで撹拌しながら、30分間で50℃まで上昇させた。浴温を50℃に保ったまま、更に1時間反応させ液組成物(ゾル液)を得た。このゾル液をメタノール/エチレングリコール=20/1 (重量比)で0.5重量%になるように希釈して基板にホイラー塗布し、100℃1分乾※

*った。ひきつづいて30%の H_2SO_4 水溶液中に浸渍し、55%で2分間デスマットした後、<math>33%、20% H_2SO_4 水溶液中で、砂目立てした面に陰極を配置して、電流密度 $5A/dm^2$ において $50秒間陽極酸化したところ厚さが<math>2.7g/m^2$ であった。

> 38 g 13 g 12 g 15 g

※燥させた。その時の塗布量は 4 m g / m^2 であった。この塗布量もケイ光 X線分析法により $S \text{ i 元素量を求め、それを塗布量とした。このように処理されたアルミニウム板上に、下記組成の高感度光重合性組成物 <math>1$ を乾燥塗布重量が 1 . 5 g / m^2 となるように塗布し、100 Cで 1 分間乾燥させ、感光層を形成した。

[0196]

〔光重合性組成物1〕

テトラメチロールメタンテトラアクリレート

1.5

線状有機高分子重合体 (B1)

2.0

アリルメタクリレート/メタクリル酸共重合体

(共重合モル比 80/20)

増感剤(C1)

【0197】 【化23】

[0198]

 $(\lambda_{max} THF 4 7 9 nm, \epsilon = 6. 9 \times 10^4)$

光重合開始剤 (D1)

0.2 g

【0199】 【化24】

* [0200]

IRGACURE907 (E1) (Ciba-Geigy社製) 0.4 第5表に示すフッ素系ポリマー (P) 0.2 ε-フタロシアニン/ (B1) 分散物 0.2 フッ素系ノニオン界面活性剤メガファックF177 0.03 (大日本インキ化学工業(株)製) メチルエチルケトン 9.0 プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 7. 5 トルエン 11.0 2

(現像液)

1 Kケイ酸カリウム 水酸化カリウム

水

【0204】各サンプルを60℃に3日間保存後同様に露光現像し印刷し、非画像部の汚れ性も目視評価し経時安定性を評価した。印刷スタートから5000枚目にPSプレートクリーナーCL-2を印刷用スポンジにしみこませ、網点部をふき版面のインキを洗浄した。その後

※m)を用い0. 15 mJ/cm^2 で、4000 dpi、 175線/インチの条件で、1%きざみで $1\sim99\%$ を それぞれ2箇所づつ露光した。その後120%に20秒間さらすことにより後加熱処理を施した。

【0202】現像は、下記の現像液に25℃で、30秒間浸漬して行った。

30 g 15 g 1000 g

10,000枚毎に145,000枚目まで同様にPSプレートクリーナーCL-2で版面のインキを洗浄し、150,000枚印刷した。10,000枚毎に印刷物を抜き取り、PSプレートクリーナーCL-2で版面を洗浄した網点と洗浄しない網点を評価した結果を第5表に示す。

【0205】なおベタ耐刷性とは、ベタ印刷部に素抜けが等がおこることなく正常に印刷できる枚数を示し、ハイライト耐刷性は175線/インチの2%の網点が印刷物上で再現する印刷枚数を示すものである。 階調は、上述の感度評価したサンプルのクリアー段数とベタ段数の差を表した。この値が低い程硬調であることを示す。

[0206]

【表5】

5 麦

	ファ素系ポリマー グレースケール 段数 階 調		耐刷性 (万枚)		
	7730714-71	(^* 3/F-N)		ベタ	ハイライト
実施例5	P – 1	3. 0/8. 0	5. 5	10	6
実施例6	P-2	3. 0/8. 0	5. 0	10	6 -
実施例 7	P-3	3. 0/8. 0	4. 5	10	6
実施例8	P – 7	3. 0/8. 0	5. 0	10	6
実施例9	P-12	3. 0/8. 0	5. 5	10	6
比較例2	添加なし	2. 0/8. 0	6	10	6

【0207】以上の結果から、本発明の感光性平版印刷 版において、感光性樹脂組成物に本発明の特有のフッ素 ったまま、印刷版の画像を硬調化することができた。

【0208】次に、熱架橋型平版印刷版の実施例につい て示す。

<架橋剤〔KZ-1〕の構造>

[0209]

【化25】

【0210】<架橋剤 [KZ-2] の構造>

[0211]

【化26】

*

40

下塗り液 βーアラニン フェニルホスホン酸 メタノール 純水

*【0212】<バインダーポリマー [BP-1] の入手 >丸善石油化学(株)製のポリ (p-ヒドロキシスチレ 系ポリマーを使用することにより、印刷版の耐刷性を保 20 ン)、マルカ リンカーM S-4P (商品名)を入手 し、 [BP-1] とした。

> 【0213】〔実施例10~13〕厚さ0.30mmの アルミニウム板(材質1050)をトリクロロエチレン 洗浄して脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュ のパミストンー水懸濁液を用いその表面を砂目立てし、 よく水で洗浄した。この板を45℃の25%水酸化ナト リウム水溶液に9秒間浸潰してエッチングを行い水洗 後、さらに2%HNO₃に20秒間浸漬して水洗した。 この時の砂目立て表面のエッチング量は約3g/m²で 30 あった。次にこの板を7%H₂SO₄を電解液として電流 密度15A/d m²で3g/m²の直流陽極酸化皮膜を設 けた後、水洗乾燥した。次にこのアルミニウム板に下記 下塗り液を塗布し、80℃で30秒間乾燥した。乾燥後 の被覆量は10mg/m²であった。

[0214]

0.1 0.05g40 g 60

【0215】次に、下記溶液〔G〕を調製し、この溶液 $*\sim$ [G-4] を得た。乾燥後の被覆量は $1.5 \mathrm{g/m^2}$ を、上記の下塗り済みのアルミニウム板に塗布し、10 であった。 0 \mathbb{C} τ 1 分間乾燥してネガ型平版印刷用版材 [G-1] * [0216]

溶液〔G〕

フッ素系ポリマー		0.	05 g
酸発生剤 [SH-1]		0.	3 g
架橋剤		0.	5 g
バインダーポリマー [BP-1]		1.	5 g
赤外線吸収剤〔【K-1〕		0.	07 g
AIZEN SPILON BLUE C-RH		Ο.	035g
(保土ヶ谷化学(株)製)			
メガファックスF-177		0.	0 1 g
(大日本インキ化学工業(株)製、フッ素系界面活性剤)			
メチルエチルケトン	1	2	g
メチルアルコール	1	0	g
1ーメトキシー2ープロパノール		8	g

【0217】ネガ型平版印刷用版材 [G-1] ~ [G-4〕に用いたフッ素系ポリマー、及び架橋剤を第6表に 示す。また、酸発生剤 [SH-1] 及び赤外線吸収剤 ※

※ [IK-1] の構造を以下に示す。

[0218]

【表 6】

実施例 番 号	平版印刷版用版 材の種類	含ファ紫共ポリマー の種類	架橋剤の 種 類
実施例10	(G-1)	(P-1)	(KZ-1]
実施例11	(G-2)	(P-2)	(KZ-1)
実施例12	(G-3)	[P-4]	(KZ-1)
実施例13	(G-4)	[P-12]	(KZ-2)

[0219]

$$\begin{array}{c|c} CI & & \\ & & \\ \stackrel{N}{C}H_3 & & \stackrel{I}{C}H_3 \end{array}$$
 [1K-1]

【0220】得られたネガ型平版印刷用版材 [G-1] ~ [G-4] の表面を素手で触り、その後、波長820 ~850nm程度の赤外線を発する半導体レーザで走査 露光した。露光後、パネルヒーターにて、110℃で3 50 を、目視で判断したが、ネガ型平版印刷用版材 [G-

0秒間加熱処理した後、富士写真フイルム (株) 製現像 液、DP-4(1:8の水希釈液)にて現像した。画像 形成後、素手で触った部分の画像が抜けているかどうか

1] \sim [G-4] おいては、明確な画像抜けは生じてい なかった。

【0221】 [比較例3] 実施例10で用いた溶液 [G] において、フッ素系ポリマーP-1を使用しなか った以外は、実施例10と同様にして、溶液を調製し た。この溶液を、実施例10で用いた下塗り済みのアル ミニウム板に塗布し、100℃で1分間乾燥してネガ型 平版印刷用版材〔Q-1〕を得た。乾燥後の重量は1. 5g/m²であった。得られた平版印刷用版材〔Qー 1〕を、実施例10と同様の操作で画像形成した。画像 10 形成後、素手で触った部分の画像が抜けているかどうか を、目視で判断したが、ネガ型平版印刷用版材〔Qー 1〕おいては、明確な画像抜けが生じていた。

【0222】次に、サーマルポジ型平版印刷版の実施例 について示す。

〔共重合体1の作成〕 攪拌機、冷却管及び滴下ロートを 備えた20ml三ツロフラスコに、N-(p-アミノス ルホニルフェニル) メタクリルアミド4. 61g (0. 0192モル)、メタクリル酸エチル2.94g(0. 0258 モル)、アクリロニトリル 0.80 g (0.0 20 砂目立て表面のエッチング量は約3 g / m²であった。 15モル)及びN, N-ジメチルアセトアミド20gを 入れ、湯水浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌 した。この混合物に「V-65」(和光純菜(株)製) 0. 15gを加え65℃に保ちながら窒素気流下2時間 混合物を撹拌した。この反応混合物にさらにN-(p-アミノスルホニルフェニル) メタクリルアミド4. 61*

下塗り液

【0225】さらに、ケイ酸ナトリウム2.5重量%水 溶液で30℃で10秒処理し、下記下塗り液を塗布し、 塗膜を80℃で15秒間乾燥し基板を得た。乾燥後の塗※

下塗り液

水

0.3g100 1 ★ ★【化28】

[0227]

【0228】〔実施例14〕以下の感光液1を調製し た。得られた基板に、この感光液1を塗布量が1.8 g☆ 感光液1

☆/m²になるよう塗布し、平版印刷版を得た。 [0229]

フッ素系ポリマー P-7 0.03g上記共重合体1 · 0. 75g m、p-クレゾールノボラック <math>(m,p) 比=6/4、 0.25g

* g、メタクリル酸エチル 2. 9 4 g、アクリロニトリル O. 80g、N, N-ジメチルアセトアミド及び「V-65」0.15gの混合物を2時間かけて滴下ロートに より滴下した。滴下終了後さらに65℃で2時間得られ た混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40gを混 合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リットルに この水を撹拌しながら投入し、30分混合物を撹拌した 後、析出物をろ過により取り出し、乾燥することにより 15gの白色固体を得た。ゲルパーミエーションクロマ トグラフィーによりこの特定の共重合体1の重量平均分 子量(ポリスチレン標準)を測定したところ53,00 0であった。

【0223】 [基板の作製] 厚み0. 3mmのアルミニ ウム板(材質1050)をトリクロロエチレンで洗浄し て脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュのパミ ストンー水懸濁液を用いこの表面を砂目立てし、水でよ く洗浄した。この板を45℃の25%水酸化ナトリウム 水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い、水洗後、さ らに20%硝酸に20秒間浸漬し、水洗した。この時の 次にこの板を7%硫酸を電解液として電流密度15A/ d m²で3g/m²の直流陽極酸化被膜を設けた後、水洗 し、乾燥し、さらに、下記下塗り液を塗布し、塗膜を9 0℃で1分乾燥した。乾燥後の塗膜の塗布量は10mg /m²であった。

[0224]

0.5g 9 5 g

g

※膜の被覆量は 15 mg/m^2 であった。 [0226]

80

重量平均分子量3,500 、未反応クレゾール

0.5重量%含有)

p-トルエンスルホン酸 0.003g テトラヒドロ無水フタル酸 0.03gシアニン染料 (下記構造) 0.017g ビクトリアピュアブルーBOHの対イオンを 0.015g

1-ナフタレンスルホン酸アニオンにした染料

メガファックF-177

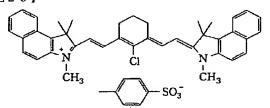
0.05g

(大日本インキ化学工業(株)製、フッ素系界面活性剤)

y ープチルラクトン 10 g メチルエチルケトン 10 g 1-メトキシー2-プロパノール 1 g

20

[0230] 【化29】



シアニン染料A

【0231】得られた平版印刷版について、外傷に対す

る現像安定性を評価した。評価結果を第7表に示す。 【0232】 (外傷に対する現像安定性) 得られた平版 印刷版を、出力500mW、波長830nm、ビーム径 17μm (1/e²) の半導体レーザを用いて主走査速 度5m/秒にて露光した後、連続荷重式引掻強度試験器 「SB62型」(新東科学(株)製)を用い、引掻治具 30 の版上に当たる1 c m角の正方形平面部分にアドバンテ ック東洋社製の「No. 5C」濾紙を張り付けて、10 0gの荷重を載せて、6cm/秒の速度で引っ掻き、富 士写真フイルム (株) 製現像液、DP-4 (1:8) で 30秒間現像した。評価は以下の基準により行った。 引掻いた部分の感光膜が完全に溶解している場合;× 引掻いた部分の感光膜が部分的に溶解している場合;△ 引掻いた部分の感光膜が全く溶解していない場合;○

[0233]

【表7】

	外傷に対する現像安定性
奥施例 14	0
実施例 15	0
実施例 16	0
比較例 4	×

【0234】〔実施例15、16、比較例4〕フッ素系 ポリマーP-7の代わりにそれぞれフッ素系ポリマーP -1、P-2を使用した以外は実施例14と同様にし て、平版印刷版を得た。また、本発明のフッ素系ポリマ ーP-7を含ませないものを比較例4とした。得られた 平版印刷版について、実施例14と同様に外傷に対する 現像安定性を評価した。評価結果を第7表に示す。第7 表から、特定のフッ素系ポリマーの添加により、現像前 の状態において、外傷に対する安定性が向上しているこ とが分かる。

[0235]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物は、特定のフ ッ素系ポリマーを含有することにより、その感度が低下 することなく、硬調な画像形成性を示し、かつ、焼きぼ け、白灯安全性、および現像許容性の広い満足するべき ものとなった。

40